REFLECTION PREVENTIVE FILM, POLARIZING PLATE AND DISPLAY DEVICE

Patent number: JP2003222704
Publication date: 2003_08_08

Publication date: 2003-08-08
Inventor: MIIDAMATE

Inventor: MURAMATSU YUZO; OKAWA ATSUHIRO

Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification: - international:

G02B1/11; B32B27/30; G02B5/30; G02F1/1335

- european:

Application number: JP20020023808 20020131 Priority number(s): JP20020023808 20020131

Report a data error here

Abstract of JP2003222704

P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reflection preventive film improving damage resistance by high productivity while having sufficient reflection preventive performance and antifouling property.
P>SOLUTION: In an optical film having a low refractive index layer having a refractive index of 1.88-1.05 containing at least a hard coated layer and a fluorine-contained polymer on a transparent support, the reflection preventive film contains a compound expressed by the following formula on at least one layer of the hard coated layer or the low refractive index layer. (R-SP>-14/SP-):n-Si(OR-SP>-2/SP-):a substituted or non-substituted alkyl group or anyl group. R-SSP>-2/SP-):a substituted or non-substituted alkyl group or anyl group. (m) is an integer of 0-3. (n) is an integer of 1-4. The total of adding (m) to (n) is 41. SP-2-OPYRIGHT: (C)2003.)PO

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本**国特許**庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-222704 (P2003-222704A)

(43)公開日 平成15年8月8日(2003.8.8)

(51) Int.Cl.7		徽別記号	ΡI			テーマコード(参考)
G02B 1	/11		B 3 2 B	27/30		D 2H049
B32B 27	/30		G 0 2 B	5/30		2H091
G02B 5	/30		G 0 2 F	1/1335		2K009
G02F 1	/1335				510	4F100
		510	G 0 2 B	1/10		A
			審查請求	未請求	請求項の数5	OL (全27頁)
(21)出願書号		特臘2002-23808(P2002-238	808) (71)出願		95201 写真フイルム株式	会社
(22)出棄日		平成14年1月31日(2002.1.31)	神奈	川県南足柄市中部	3210番地
			(72)発明	者 村松	雄遊	
				神奈	川県南足柄市中都	3210番地 富士写真
				フイ	ルム株式会社内	
			(72)発明	者大川	教裕	
				神奈	川県南足柄市中都	3210番地 富士写真
				フイ	ルム株式会社内	
			(74)代理	人 1001	05647	
				弁理	士 小栗 昌平	(外4名)

(54) [発明の名称] 反射防止フィルム、偏光板およびディスプレイ装置

(57) 【要約】

【課題】十分な反射防止性能と防汚性を有しながら耐傷性の向上した反射防止フィルムを高い生産性で提供す

【解決手段】透明支持体上に、少なくともハードコート 層と含フッ素ポリマーを含む歴折率が1.38~1.4 9の低度折率層を有する光学フィルムにおいて、該ハー ドコート層乃至低度折率層の少なくとも1層に下記式で 未される化合物を含有する反射防止フィルム

(R1) m-Si (OR2) n

(式中、R¹は置換もしくは無置換のアルキル基もしく は、アリール基を表す。R²は置換もしくは無置換のア ルキル基もしくはアシル基を表す。mは0~3の整数を 表す。nは1~4の整数を表す。mとnの合計は4であ る。)

【特許請求の範囲】

[請求項·] 適明支持体上に、少なくともハードコート層と含フッ素ポリマーを含む歴折率が1.38~1.49の低距折率階を有する光学フィルムにおいて、該ハードコート層介至低距折率層の少なくとも1層に下記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とする反射的比フィルム。

一般式 (1)

(R1) m-Si (OR2) n

(式中、R¹は曹挽もしくは無重検のアルキル基もしく は、アリール基を表す。R²は置検もしくは無置検のア ルキル基もしくはアシル基を表す。mは0~3の整数を 表す。nは1~4の整数を表す。mとnの合計は4であ る。)

[講来環2] 透明支持体上に、少なくともハードコート層と含っツ素ポリマーを含む風折率が1、38~1. 49の低脂が無降を塗散する講来項1配板の反射防止フィルムの製造方法において、試ハードコート層乃至低鼠折率層の少なくとも1層の差布液が一般式(1)で表される化合機を含有することを特徴とする反射防止フィルムの製造方法。

【請求譲る】 ロール形態の透明支持体を重揉的に懸き 出し、眩巻き出された支持体の一方の側に、少なくとも ハードコート層と含フッ葉ポリマーを含む底匿折率層の 内の少なくとも一層をマイクログラピアコート法によっ て塗エすることを特徴とする請求項2に記載の反射防止 フィルムの製金方法。

[請求項4] 請求項1に記載の反射防止フィルムまた は請求項2または3に記載の製造方法で製造された反射 防止フィルムを、偏光板における偏光層の2枚の保護フィルムのうちの少なくとも一方に用いたことを特徴とす る偏光板。

【請求項5】 請求項1に記載の反射防止フィルム、請 求項2または3の製造方法で製造された反射防止フィル ムまたは請求項4に記載の備光板の低屈折率層を最表層 に用いたことを特徴とするディスプレイ装置。

【発明の詳細な説明】

【発明の計機な説明。 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、反射防止フィルム、偏光板およびそれを用いたディスプレイ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】 反射防止フィルムは一般に、陸極管表示 装置 (CRT)、ブラズマディスプレイ (PDP) エレ クトロルミネッセンスディスプレイ (ELD) や液晶 来装置 (LOD) のようなディスプレイ装置において、 外光の反射によるコントラスト低下や像の映り込みを防 止するために、光学干渉の原理を用いて反射率を低減す エディスプレクの患者両下原等される。 ト層と低風折率層のみを有する反射防止フィルムにおいては、反射率を低減するためには低限防事層を十分に低 配折率化しなければならず、トリアセテルセルロースを 支持体とし、ジベンタエリスリトールへキサアクリレー トのUV硬化敏度をハードコート層とする反射防止フィ ルムで450 nmから650 nmにおける平均反射率を 1.6 94以下にするためには抵折率を1.40以下にしなければならない。医折率1.40以下の素材としては 繊物ではフッ化マグネシウムやフッ化カルシウム、有 繊物ではフッポ音率の大きい言フッ素化合物が手げられ あが、これらフッ素化合物が返業力がないためディスプ レイの最表面に配置するフィルムとしては解極性が不足 していた。後つて、十分な影像性を有するためには1、 43以上の服折率を有する付合物が必要であった。

[0004]特闘平アー287102号においては、ハードコート層の展析率を大きくすることにより、反射率を低減させることが記載されている。しかしながら、このような裏折率ハードコート層は支持体との展析率差が大きいためにフィルムの色むらが発生し、反射率の波長依存性も大きく振幅してしまう。

[0005] また特開平7-333404号においては、ガスパリア性、防眩性、反射防止性に優大る防眩性 反射防止腹が配観されているが、CVDによる酸化珪素 酸が必須であるため、ウェット塗布と比較して生産性が まる。

[0006]

【発明が解決しようとする問題】 本発明の目的は、十分 な反射防止性能と防汚性を有しながら耐傷性の向上した 反射防止フィルな程限することにある。 さらにはその ような反射防止フィルムを高い生産性で提供することで ある。さらにはそのような反射防止フィルムを用いた偏 光極やディスプレイ装置を提供することにある。

[0007]

[課題を解決するための手段] 本発明によれば、下記構成の反射防止フィルム、偏光板及びディスプレイ装置が 提供され、上記目的が達成される。

- (1) 透明支持体上に、少なくともハードコート層と含 フッ素ポリマーを含む昆折率が1.38~1.49の低 屈折率層を有する光学フィルムにおいて、該ハードコー ト層乃至低屈折率層の少なくとも1層に下記一般式
- (1) で表される化合物を含有することを特徴とする反射防止フィルム。

一般式(1)

(R¹) m-Si (OR²) n

(式中、R¹は置換もしくは無置換のアルキル基もしく は、アリール基を表す。R²は置換もしくは無置換のア ルキル基もしくはアシル基を表す。mは0~3の整数を 表す。nは1~4の整数を表す。mとnの合計は4であ る。)

- ドコート層であることを特徴とする (1) に記載の反射 防止フィルム。
- (3) 該防眩性ハードコート層の下層に、さらに防眩性 を有しないハードコート層を有することを特徴とする
- (2) に記載の反射防止フィルム。
- (4) 該防眩性ハードコート層がパインダーと平均粒径 1.0~10.0μmのマット粒子から形成され、該パインダーの屈折率が1.48~2.00であることを特
- 機とする (2) ~ (3) に配載の反射防止フィルム。 (5) 該ハードコート層にジルコニウム、チタン、アル ミニウム、インジウム、亜鉛、錫、アンチモン、および ケイ素のうちより選ばれる少なくとも1つの酸化物から
- なる無機フィラーを含有することを特徴とする(1)~ (4)に記載の反射防止フィルム。
- (6) 該低屈折率層にシリカ、およびフッ化マグネシウムより選ばれる無機フィラーを含有することを特徴とする(1)~(5) に記載の反射防止フィルム。
- (7)該防眩性ハードコート層より下層の防眩性を有しないハードコート層にシリカ、およびアルミナより選ばれる無機フィラーを含有することを特徴とする(3)~
- (6) に記載の反射防止フィルム。
- (8)全てのハードコート層および低屈折率層に無機フィラー粒子を含有することを特徴とする(1)~(7)に記載の反射防止フィルム。
- (9) 該無機フィラーの平均粒径が0.001~0.2 μmであることを特徴とする(5)~(8) に記載の反射防止フィルム。
- (10) 該低屈折率層側表面の動摩擦係数が0.03~0.15であり、かつ、水に対する接触角が90~120°であることを特徴とする(1)~(9)に配載の反射防止フィルム。
- (11) 該ハードコート層の表面エネルギーが25mN·m⁻¹~70mN·m⁻¹であることを特徴とする(1) ~ (10) に記載の反射防止フィルム。
- (12)該防眩性ハードコート層がフッ素系および/またはシリコーン系の界面活性剤を含有することを特徴と
- たはシリコーン系の不固治は稀を含有することではな する(2)~(11)に記載の反射防止フィルム。 (13)該防眩性ハードコート層がX線光電子分光法で
- (13) 飲いなほパートコードョル・へをからす。からないま 第定したフッ素原子由来のピークと炭素原子由来のピークの比であるF/Cがの、40以下、および/またはシ リコン原子由来のピークと炭素原子由来のピークの比で あるSi/Cがの、30以下であることを特徴とする
- (2)~(12)に記載の反射防止フィルム。
- (14) ヘイズが3.0~50.0%であり、450~650nmの平均反射率が2.2%以下であることを特徴とする(1)~(13)に記載の反射防止フィルム。
- (15) 該透明支持体がトリアセチルセルロース、ポリ エチレンテレフタレート、またはポリエチレンナフタレ ートでもスコトを結婚とする(1)~(14)に記載の

- (16) 低屈折率層を有する側とは反対側の透明支持体 の表面の水に対する接触角が40°以下であることを特 徴とする(1)~(15)に記載の反射防止フィルム。
- (17) 一般式(1)で表される化合物のRIの電機基が置合性のアシルオキシ基、またはエポキシ基であることを特徴とする(1)~(16)に配載の反射防止フィルム。
- (18) 通明支持体上に、少なくともハードコート層と 言フッ素ポリマーを含む屋折率が1、38~1、49の 低屈折率層を塗蓋する(1)~(17)に登慮の反射防 止フィルムの製造方法において、該ハードコート層乃至 低屈折率層の少なくとも1層の塗布液が一般式(1)で 表の出れる化物を含有することを特徴とする反射防止フ ィルムの製造方法。
- (19) 透明支持体上に低屈折率層を形成した後、鹸化 処理することにより得られることを特徴とする (18) に記載の反射防止フィルムの製造方法。
- (20) 低屈折率層が塗布工程により形成され、該低配 折率層用塗布液の溶媒が少なくとも1種の溶媒からな り、該溶媒の50~100質量%が沸点100℃以下の 溶媒からなることを特徴とする(18)または(19) に配数の反射防止フィルムの製造方法。
- (21) 低屈折率雇用塗布液の溶媒がケトン類および/ またはエステル類であることを特徴とする(18)~
- (20) に記載の反射防止フィルムの製造方法。 (22) ロール形態の透明支持体を連続的に巻き出し、
- 該巻き出された支持体の一方の側に、ハードコート層乃 至含フツ素ポリマーを含む低度折率層の内のかなくとも 一層をマイクログラピアコート法によって塗工すること を特徴とする (18) ~ (21) に配載の反射防止フィ ルムの製造方法。
- (23) (1) ~ (17) に記載の反射防止フィルムまたは (18) ~ (22) に記載の反射防止フィルムを、偏光低における偏光形に形態の契違方法で契違された反射防止フィルムのうちの少なくとも一方に用いたことを特徴とする偏光形。 (24) (1) ~ (17) に記載の反射防止フィルム (18) ~ (22) の契違方法で契違された反射防止フィルムまたは (23) に記載の偏光振の低肥折手履を最表層に用いたことを特徴とするディスプレイ装置。

[8000]

[発明の実施の形態] 本発明の実施の一形態として好適 な反射防止フィルムの基本的な構成を図面を参照しなが ら説明する。

[0009] 図1に模式的に示される態様は本発明の反 射防止フィルムの一例であり、この場合、反射防止フィ ルム1は、透明支持体2、ハードコート層3、防眩性ハ ードコート層4、そして低阻抗率層5の順序の層構成を 有する。防眩性ハードコート層4には、微粒千6が分散 分の素材の屋折率が1.57~2.00の範囲にあることが好ましく、低屋折率層5の屋折率は1.38~1.49の範囲にあることが好ましい。本祭明においてはハードコート層はこのように的致性を有するハードコート層でもよいし、防険性を有しないハードコート層でもなく、1層でもよいし、複数層(例えば2層/D至4層で構成されていてもよい。従って図1に示したハードコート層 3は必須ではないがフィルム強度付与のために塗設されることが好ましい。同様に低屋折率層においても1層で構成されていてもよいし、複数層で構成されていてもよいし、複数層で構成されていてもよいし、

【0010】本発明のハードコート層と低屈折率層のうちの少なくとも1層には、下記一般式(1)の化合物が含有される。

一般式(1)

(R1) m-Si (OR2) n

一般式 (1) 式中、R¹は置換もしくは無置換のアルキ ル基もしくは、アリール基を表す。R²は置換もしくは 無置換のアルキル基もしくはアシル基を表す。mは0~ 3の整数を表す。nは1~4の整数を表す。mとnの合 計は4である。一般式(1)で表される化合物について 説明する。一般式 (1) においてR¹は置換もしくは無 置換のアルキル基もしくはアリール基を表す。アルキル 基としてはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、 ヘキシル、t-ブチル、sec-ブチル、ヘキシル、デシ ル、ヘキサデシル等が挙げられる。アルキル基として好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~1 6、特に好ましくは1~6のものである。アリール基と してはフェニル、ナフチル等が挙げられ、好ましくはフ ェニル基である。置換基としては特に制限はないが、ハ ロゲン(フッ素、塩素、臭素等)、水酸基、メルカプト 基、カルボキシル基、エポキシ基、アルキル基(メチ ル、エチル、iープロピル、プロピル、tーブチル 等)、アリール基(フェニル、ナフチル等)、芳香族へ テロ環基(フリル、ピラゾリル、ビリジル等)、アルコ キシ基(メトキシ、エトキシ、i ープロポキシ、ヘキシ ルオキシ等)、アリールオキシ(フェノキシ等)、アル キルチオ基(メチルチオ、エチルチオ等)、アリールチ オ基(フェニルチオ等)、アルケニル基(ピニル、1ー プロペニル等)、アルコキシシリル基(トリメトキシシ リル、トリエトキシシリル等)、アシルオキシ基(アセ トキシ、アクリロイルオキシ、メタクリロイルオキシ 等)、アルコキシカルボニル基(メトキシカルボニル、 エトキシカルボニル等)、アリールオキシカルボニル基 (フェノキシカルボニル等)、カルバモイル基(カルバ モイル、Nーメチルカルパモイル、N. Nージメチルカ ルバモイル、NーメチルーNーオクチルカルバモイル 等)、アシルアミノ基(アセチルアミノ、ベンゾイルア トリリマト / メタクリルアミノ等)等が好主 ト基、カルボキシル基、エボキシ基、アルキル基、アル コキシシリル基、アシルオキシ基、アシルアミノ基であ り、特に好ましくはエポキシ基、重合性のアシルオキシ 基 (アクリロイルオキシ、メタクリロイルオキシ)、重 合性のアシルアミノ基 (アクリルアミノ、メタクリルア ミノ)である。またこれら置換基は更に置換されていて も良い。R²は置換もしくは無置換のアルキル基もしく はアシル基を表す。アルキル基、アシル基ならびに置換 基の説明はR1と同じである。R2として好ましくは無置 換のアルキル基もしくは無置換のアシル基であり、より 好ましくは無置換のアルキル基であり、特に好ましくは 炭素数1~4の無面機のアルキル基である。mは0~3 の整数を表す。nは1~4の整数を表す。mとnの合計 は4である。R¹もしくはR²が複数存在するとき、複数 のR1もしくはR2はそれぞれ同じであっても異なってい ても良い。mとして好ましくは0、1、2であり、特に 好ましくは1である。以下に一般式(1)で表される化 合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるも のではない。

[0011]

[化1]

(1) (C₂H₅O)₄-Si

- (2) (CaH7O);-Si
- (3) G-CaHrO\u-Si
- (4) (CH₃CO₃)₄-Si
- (5) (CH₈CO₂)₂-Si-(OC₂H₅)₂
- (6) CH₂-Si-(OC₂H₅)₃
- (7) CaHs-Si-(OCaHs)a
- (8) t-C₄H₉-Si-(OCH₃)₂
- (9)

[0012]

$$\begin{array}{c} \text{(1.4)} \\ & \text{$C_2\text{H}_{5}$} & \text{$C\text{IH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OCH}_{9})_1$} \\ \\ \text{(1.5)} & \text{$C_2\text{H}_{5}$} & \text{$C\text{IH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OC}_2\text{H}_{9})_3$} \\ \\ \text{(1.6)} & \text{$C_2\text{H}_5\text{CH}_5\text{CH}_5\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OC}_3\text{H}_{9})_4$} \\ \\ \text{(1.7)} & \text{$C\text{O}_2\text{H}_3\text{CH}_3\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OC}_3\text{H}_{9})_4$} \\ \\ \text{(1.7)} & \text{$C\text{O}_2\text{CH}_3\text{CH}_3\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OC}_3\text{H}_{9})_4$} \\ \\ \text{(1.8)} & \text{$C\text{O}_2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OC}_4\text{H}_{9})_3$} \\ \\ \text{(1.9)} & \text{$C\text{O}_3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OCH}_{9})_3$} \\ \\ \text{$C\text{O}_3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OCH}_{9})_3$} \\ \\ \text{$C\text{O}_3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OC}_{9})_2$} \\ \\ \text{$C\text{O}_3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OCH}_{9})_2$} \\ \\ \text{$C\text{O}_3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OCH}_{9})_2$} \\ \\ \text{$C\text{O}_3\text{O}_3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{-}S\text{-}} \cdot (\text{OCH}_{9})_2$} \\ \\ \text{$C\text{O}_3\text{O}_3\text{CH}_3\text{CH}_3\text{-}} \cdot (\text{OCH}_3\text{-})_2$} \\ \\ \text{$C\text{O}_3\text{CH}_3\text{CH}_3\text{-}} \cdot (\text{OCH}_3\text{-})_3$} \\ \\ \\ \text{$C\text{O}_3\text{$$

[化4]

[0016]

【0017】これもの具体傾向中で、(1)、(1 2)、(18)、(19)等が特に好ましい。一般式 (1)の化た物の適宜な含有量は、比較的原理な下層の 場合は少なく、薄膜な素面層の場合は多く必要である が、含有層(添加層)の全層形がの3~600質量%が 対ましく、5~300質量%がより好ましく、10~2 00質量%が患り好ましい。未実明においてはハードコ

ĊНз

法としてはこれらハードコート層乃至低屈折率層の少な くとも1層の塗布液に含有せしめて塗設することが好ま しい。

【〇〇18】本発明の反射防止フィルム社通明支持体上 にハードコート層を有し、さらにその上に低度折率層を 有するが、要求される性能に応じ、該ハードコートの一 層を防眩性ハードコート層とした反射防止フィルムとす ることができる。本発明の反射防止フィルムでは接強度 空向上させる目的で防眩性ハードコート層で居にさら に防眩性ではないハードコート層を設けることもでき

【0019】さらに支持体上の各層に無機フィラーを添 加することが好ましい。各層に添加する無機フィラーは それぞれ同じでも異なっていても良く、各層の屈折率、 膜強度、膜厚、塗布性などの必要性能に応じて、種類、 添加量、は適宜調節されることが好ましい。本発明に使 用する無機フィラー形状は特に制限されるものではな く、例えば、球状、板状、繊維状、棒状、不定形、中空 等のいずれも好ましく用いられるが、球状が分散性がよ くより好ましい。また、無機フィラーの種類についても 特に制限されるものではないが、非晶質のものが好まし く用いられ、金属の酸化物、窒化物、硫化物またはハロ ゲン化物からなることが好ましく、金属酸化物が特に好 ましい。金属原子としては、Na、K、Mg、Ca、B a, Al, Zn, Fe, Cu, Ti, Sn, In, W, Y. Sb. Mn. Ga. V. Nb. Ta. Ag. Si. B、Bi、Mo、Ce、Cd、Be、PbおよびNi等 が挙げられる。無機フィラーの平均粒子径は、透明な硬 化膜を得るためには、0.001~0.2μmの範囲内 の値とするのが好ましく、より好ましくは0.001~ 1 μm、さらに好ましくは0.001~0.06 μ mである。ここで、粒子の平均粒径はコールターカウン ターにより測定される。本発明における無機フィラーの 使用方法は特に制限されるものではないが、例えば、乾 燥状態で使用することができるし、あるいは水もしくは 有機溶媒に分散した状態で使用することもできる。本発 明において、無機フィラーの凝集、沈降を抑制する目的 で、分散安定化剤を併用することも好ましい。分散安定 化剤としては、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロ リドン、セルロース誘導体、ポリアミド、リン酸エステ ル、ポリエーテル、界面活性剤および、本発明に係る一 般式 (1) の化合物も含め、シランカップリング剤、チ タンカップリング剤、等を使用することができる。特に シランカップリング剤が硬化後の皮膜が強いため好まし い。分散安定化剤としてのシランカップリング剤の添加 量は特に制限されるものではないが、例えば、無機フィ ラー100質量部に対して、1質量部以上の値とするの が好ましい。また、分散安定化剤の添加方法も特に制限 ンカップリング剤と無機フィラーとを混合後、さらに加 水分解および総合する方法を得ることができるが、後者 の方がより好ましい。また本発明の一般式(1)の代合 物は、無線フィラーの分散で定化剤として用いられる以 外に、さらに各層のバインダー構成成分の一部として、 塗布液調製時の添加剤としても用いることが好ましい。 各層に適する無機フィラーについてはそれぞれ後述す る。

【0020】本発明の防眩性ハードコート層について以 下に説明する。防眩性ハードコート層はハードコート性 を付与するためのパインダー、防眩性を付与するための マット粒子、および高屈折率化、架橋収縮防止、高強度 化のための無機フィラー、から形成される。パインダー としては、飽和炭化水素鎖またはポリエーテル鎖を主鎖 として有するポリマーであることが好ましく、飽和炭化 水素鎖を主鎖として有するポリマーであることがさらに 好ましい。また、バインダーポリマーは架橋構造を有す ることが好ましい。飽和炭化水素鎖を主鎖として有する パインダーポリマーとしては、エチレン性不飽和モノマ 一の重合体が好ましい。飽和炭化水素鎖を主鎖として有 し、かつ架橋構造を有するパインダーポリマーとして は、二個以上のエチレン性不飽和基を有するモノマーの (共) 重合体が好ましい。高屈折率にするには、このモ ノマーの構造中に芳香族環や、フッ素以外のハロゲン原 子、硫黄原子、リン原子、及び窒素原子から選ばれた少 なくとも1種の原子を含むことが好ましい。

【〇〇21】二個以上のエチレン性不飽和基を有するモ ノマーとしては、多価アルコールと(メタ)アクリル酸 とのエステル(例、エチレングリコールジ(メタ)アク リレート、1、4ージクロヘキサンジアクリレート、ペ ンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリレート)、ベ ンタエリスリトールトリ (メタ) アクリレート、トリメ チロールプロパントリ (メタ) アクリレート、トリメチ ロールエタントリ (メタ) アクリレート、ジベンタエリ スリトールテトラ (メタ) アクリレート、ジベンタエリ スリトールベンタ (メタ) アクリレート、ベンタエリス リトールヘキサ (メタ) アクリレート、1、2、3ーシ クロヘキサンテトラメタクリレート、ポリウレタンポリ アクリレート、ポリエステルポリアクリレート)、ビニ ルベンゼンおよびその誘導体(例、1、4 - ジビニルベ ンゼン、4ービニル安息香酸ー2ーアクリロイルエチル エステル、1、4ージビニルシクロヘキサノン)、ビニ ルスルホン(例、ジビニルスルホン)、アクリルアミド (例、メチレンピスアクリルアミド) およびメタクリル アミドが挙げられる。上記モノマーは2種以上併用して もよい。

00022】高屈折率モノマーの具体例としては、ピス (4-メタクリロイルチオフェニル)スルフィド、ピニ ロナフタレン、ピニルフェニルスルフィド、4-メタク ル等が挙げられる。これらのモノマーも2種以上併用してもとい

【0023】これらのエチレン性不飽和基を有するモノ マーの重合は、光ラジカル開始剤あるいは熟ラジカル開 始剤の存在下、電離放射線の照射または加熱により行う ことができる。従って、エチレン性不飽和基を有するモ ノマー、光ラジカル開始剤あるいは熱ラジカル開始剤、 マット粒子および無機フィラーを含有する塗液を調製 し、該塗液を透明支持体上に塗布後電離放射線または熱 による重合反応により硬化して反射防止フィルムを形成 することができる。光ラジカル重合開始剤としては、例 えば、アセトフェノン類、ベンゾフェノン類、ミヒラー のベンゾイルベンゾエート、一アミロキシムエステル、 テトラメチルチウラムモノサルファイドおよびチオキサ ントン類等が挙げられる。特に、光開裂型の光ラジカル 重合開始剤が好ましい。光開裂型の光ラジカル重合開始 剤については、最新UV硬化技術 (P. 159, 発行人:高 薄一弘,発行所;(株)技術情報協会、1991年発 行)に記載されている市販の光開裂型の光ラジカル重合 開始剤としては、日本チバガイギー(株)製のイルガキ ュア (651、184、907) 等が挙げられる。光重 合開始剤は、多官能モノマー100質量部に対して、 O. 1~15質量部の範囲で使用することが好ましく、 より好ましくは1~10質量部の範囲である。光重合開 始剤に加えて、光増感剤を用いてもよい。光増感剤の具 体例として、nーブチルアミン、トリエチルアミン、ト リーn-ブチルホスフィン、ミヒラーのケトンおよびチ オキサントンを挙げることができる。

【〇〇24】ポリエーテルを主鎖として有するポリマー は、多官能エポシキシ化合物の開環重合体が好ましい。 多官能エポシキ化合物の開環重合は、光酸発生剤あるい は熱酸発生剤の存在下、電離放射線の照射または加熱に より行うことができる。従って、多官能エポシキシ化合 物、光酸発生剤あるいは熱酸発生剤、マット粒子および 無機フィラーを含有する塗液を調製し、該塗液を透明支 特体上に塗布後電離放射線または熱による重合反応によ り硬化して反射防止フィルムを形成することができる。 【0025】二個以上のエチレン性不飽和基を有するモ ノマ―の代わりにまたはそれに加えて、架橋性官能基を 有するモノマーを用いてポリマー中に架橋性官能基を導 入し、この架橋性官能基の反応により、架橋構造をパイ ンダーポリマーに導入してもよい。架橋性官能基の例に は、イソシアナート基、エポキシ基、アジリジン基、オ キサゾリン基、アルデヒド基、カルボニル基、ヒドラジ ン基、カルボキシル基、メチロール基および活性メチレ ン基が含まれる。ビニルスルホン酸、酸無水物、シアノ アクリレート誘導体、メラミン、エーテル化メチロー ル、エステルおよびウレタン、テトラメトキシシランの ・4.4回フェーナン・ビナ 加修博造た道 1 するための のように、分解反応の簡果として架橋性を示す官能基を 用いてもよい。すなわち、本発明において架橋性官能基 は、すぐには反応を示すものではなくとも、分解した韓 果反応性を示すものであってもよい。これら架橋性官能 基を有するパインダーポリマーは塗布後、加艶すること によって架橋機を形成することができる。

【0026】防眩性ハードコート層には、防眩性付与の 目的で、フィラー粒子より大きな平均粒径が1~10 μ m、好ましくは1.5~7.0 µmのマット粒子、例え ば無機化合物の粒子または樹脂粒子が含有される。上記 マット粒子の具体例としては、例えばシリカ粒子、Ti O2粒子等の無機化合物の粒子;架橋アクリル粒子、架 構スチレン粒子、メラミン樹脂粒子、ベンゾグアナミン 樹脂粒子等の樹脂粒子が好ましく挙げられる。なかでも 架攉スチレン粒子が好ましい。マット粒子の形状は、真 球あるいは不定形のいずれも使用できる。また、異なる 2種以上のマット粒子を併用して用いてもよい。上記マ ット粒子は、形成された防眩性ハードコート層中のマッ ト粒子量が好ましくは10~1000mg/m²、より 好ましくは30~100mg/m²となるように防眩性 ハードコート層に含有される。また、特に好ましい態様 は、マット粒子として架橋スチレン粒子を用い、防眩性 ハードコート層の膜厚の2分の1よりも大きい粒径の架 橋スチレン粒子が、該架橋スチレン粒子全体の40~1 00%を占める態様である。ここで、マット粒子の粒度 分布はコールターカウンター法により測定し、測定され た分布を粒子数分布に換算する。

【0027】防眩性ハードコート層には、層の屈折率を 高めるために、上記のマット粒子に加えて、チタン、ジ ルコニウム、アルミニウム、インジウム、亜鉛、錫、ア ンチモンのうちより選ばれる少なくとも 1種の金属の酸 化物からなり、平均粒径がΟ. 2μm以下、好ましくは 1 μm以下、より好ましくは0.06 μm以下であ る無機フィラーが含有されることが好ましい。また逆 に、マット粒子との屈折率差を大きくするために、高屈 折率マット粒子を用いた防眩性ハードコート層では層の 屈折率を低目に保つためにケイ素の酸化物を用いること も好ましい。好ましい粒径は前述の無機フィラーと同じ である。防眩性ハードコート層に用いられる無機フィラ 一の具体例としては、TiO2、ZrO2、Al2O3、I n2O3、ZnO、SnO2、Sb2O3、ITOとSiO2 等が挙げられる。TiO2およびZrO2が高屈折率化の 点で特に好ましい。該無機フィラーは表面をシランカッ プリング処理又はチタンカップリング処理されることも 好ましく、フィラ―表面にパインダー種と反応できる官 能基を有する表面処理剤が好ましく用いられる。これら の無機フィラーの添加量は、防眩性ハードコート層の全 質量の10~90%であることが好ましく、より好まし くは20~80%であり、特に好ましくは30~75%

よりも十分小さいために散乱が生じず、パインダーポリ マーに該フィラーが分散した分散体は光学的に均一な物 質として振舞う。

【0028】本発明の防眩性ハードコート層のバインダ 一および無機フィラーの混合物の合計の屈折率は、1. 48~2.00であることが好ましく、より好ましくは 1. 50~1. 80である。屈折率を上記範囲とするに は、バインダー及び無機フィラーの種類及び量割合を適 宜選択すればよい。どのように選択するかは、予め実験 的に容易に知ることができる。

【0029】本発明の防眩性ハードコート層は、特に塗 布ムラ、乾燥ムラ、点欠陥等の面状均一性を確保するた めに、フッ素系、シリコーン系の何れかの界面活性剤、 あるいはその両者を防眩層形成用の塗布組成物中に含有 する。特にフッ素系の界面活性剤は、より少ない添加量 において、本発明の反射防止フィルムの塗布ムラ、乾燥 ムラ、点欠陥等の面状故障を改良する効果が現れるた め、好ましく用いられる。フッ素系の界面活性剤の好ま しい例としては、スリーエム社製のフロラードFC-4 3 1等のパーフルオロアルキルスルホン酸アミド基含有 ノニオン、大日本インキ社製のメガファックF-17 1、F-172、F-173、F-176PF等のパー フルオロアルキル基含有オリゴマー等が挙げられる。シ リコーン系の界面活性剤としては、エチレングリコー ル、プロピレングリコール等のオリゴマ一等の各種の置 換基で側鎖や主鎖の末端が変性されたポリジメチルシロ キサン等が挙げられる。

【0030】しかしながら、上記のような界面活性剤を 使用することにより、防眩層表面にF原子を含有する官 能基および/またはSi原子を有する官能基が偏析する ことにより防眩層の表面エネルギーが低下し、上記防眩 層上に低屈折率層をオーバーコートしたときに反射防止 性能が悪化する問題が生じる。これは低屈折率層を形成 するために用いられる塗布組成物の濡れ性が悪化するた めに低屈折率層の膜厚の目視では検知できない微小なム ラが悪化するためと推定される。このような問題を解決 するためには、フッ素系および/またはシリコーン系の 界面活性剤の構造と添加量を調整することにより、防眩

 $m\lambda/4\times0$. $7<n1d1<m\lambda/4\times1$. 3

【0035】式中、mは正の奇数であり、n1は低屈折 率層の屈折率であり、そして、 d 1は低屈折率層の膜厚 (nm) である。また、入は波長であり、500~55 Onmの範囲の値である。なお、上記数式(I)を満た すとは、上記波長の範囲において数式(I)を満たすm (正の奇数、通常1である)が存在することを意味して いる。

【0036】本発明の低屈折率層を形成する素材につい て以下に説明する。本発明の低屈折率層には、低屈折率 くノンガートして 今つッ去ポリマーを含む。今フッ素

層の表面エネルギーを好ましくは25mN・m⁻¹~70 mN·m-1に、より好ましくは35mN·m-1~70m N·m-1に制御することが効果的であり、さらに後述す るように低屈折率層の塗布溶剤を50~100質量パー セントが100℃以下の沸点を有するものとすることが 効果的であることを見出した。また、上記のような表面 エネルギーを実現するためには、X線光電子分光法で測 定したフッ素原子由来のピークと炭素原子由来のピーク の比であるF/Cが〇. 40以下、および/またはシリ コン原子由来のピークと炭素原子由来のピークの比であ るSi/CがO、3O以下であることが必要である。

【0031】防眩性ハードコート層の膜厚は1~10μ mが好ましく、1. 2~6μmがより好ましい。

【0032】本発明の反射防止フィルムでは、フィルム 強度向上の目的で防眩性ではないいわゆる平滑なハード コート層も好ましく用いられ、透明支持体とハードコー ト層の間に塗設される。平滑なハードコート層に用いる 素材は防眩性付与のためのマット粒子を用いないこと以 外は防眩性ハードコート層において挙げたものと同様で あり、バインダーと無機フィラーから形成される。本発 明の平滑なハードコート層では無機フィラーとしては強 度および汎用性の点でシリカ、アルミナが好ましく、特 にシリカが好ましい。また該無機フィラーは表面をシラ ンカップリング処理されることが好ましく、フィラ一表 面にパインダー種と反応できる官能基を有する表面処理 剤が好ましく用いられる。これらの無機フィラーの添加 量は、ハードコート層の全質量の10~90%であるこ とが好ましく、より好ましくは20~80%であり、特 に好ましくは30~75%である。平滑なハードコート 層の膜厚は1~10μmが好ましく、1.2~6μmが より好ましい。

【0033】本発明の低屈折率層について以下に説明す る。本発明の反射防止フィルムの低屈折率層の屈折率 は、1、38~1、49であり、好ましくは1、38~ 1. 44の範囲にある。さらに、低屈折率層は下記数式 (I) を満たすことが低反射率化の点で好ましい。 [0034]

数式 (I)

対する接触角90~120°の熟または電離放射線によ り架橋する含フッ素ポリマーが好ましい。本発明の低屈 折率層には膜強度向上のための無機フィラーが好ましく 用いられる。

【0037】低屈折率層に用いられる架橋性の含フッ素 ポリマーとしてはパーフルオロアルキル基含有シラン化 合物 (例えば (ヘプタデカフルオロー1、1、2、2-テトラデシル) トリエトキシシラン) 等の他、含フッ素 モノマーと架橋性基付与のためのモノマーを構成単位と する含フッ素ポリマーが挙げられる。含フッ素モノマー (例えばフルオロエチレン、ビニリデンフルオライド、 テトラフルオロエチレン、ヘキサフルオロエチレン、ヘ キサフルオロブロビレン、パーフルオロー2、2ージメ テルー1、3ージオキソール等)、(メタ)アクリル酸 の部分または完全フッ素化アルキルエステア版導体類

【0038】また上記含フッ素モノマーを構成単位とす るポリマーだけでなく、フッ素原子を含有しないモノマ 一との共重合体を用いてもよい。併用可能なモノマ一単 位には特に限定はなく、例えばオレフィン類(エチレ ン、プロピレン、イソプレン、塩化ビニル、塩化ビニリ デン等)、アクリル酸エステル類(アクリル酸メチル、 アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸2-エチルヘキシル)、メタクリル酸エステル類(メタクリ ル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチ ル、エチレングリコールジメタクリレート等)、スチレ ン誘導体(スチレン、ジビニルベンゼン、ビニルトルエ ン、αーメチルスチレン等)、ビニルエーテル類(メチ ルビニルエーテル等)、ビニルエステル類(酢酸ビニ ル、プロピオン酸ビニル、桂皮酸ビニル等)、アクリル アミド類(Nーtertブチルアクリルアミド、Nーシ クロヘキシルアクリルアミド等)、メタクリルアミド 類、アクリロニトリル誘導体等を挙げることができる。 【0039】低屈折率層に用いられる無機フィラーとし ては低屈折率のものが好ましく用いられ、好ましい無機 フィラーは、シリカ、フッ化マグネシウムであり、特に シリカが好ましい。該無機フィラーの平均粒径は0.0 01~0.2 μmであることが好ましく、0.001~ 0. 05μmであることがより好ましい。フィラーの粒 径はなるべく均一(単分散)であることが好ましい。該 無機フィラーの添加量は、低屈折率層の全質量の5~9 O質量%であることが好ましく、10~70質量%であ ると更に好ましく、10~50質量%が特に好ましい。 該無機フィラーは表面処理を施して用いることも好まし い。表面処理法としてはブラズマ放電処理やコロナ放電 処理のような物理的表面処理とカップリング剤を使用す ェル学的表面処理があるが カップリング剤の使用が好

(1) の化合物も含めたオルガノアルコキシメタル化合 物(例、チタンカップリング剤、シランカップリング 剤) が好主しく用いられる。該無機フィラーがシリカの 場合はシランカップリング無理が特に有效である。発明 に係る一般式(1) の化合物は、低風折率層の無機フィ ラーの表面是理形として該財産布溶調製以削にあらかじ め表面是理を施すために用いてもよいが、該届差布液調 製制にさらに流加剤として※加して該居に合有させるこ とが好ましい。

[0040] 本発明に係るハードコート層、低层折率層を形成するために用いる塗布液の溶媒組成としては、単数および悪色のいずれでもよく、理合のときは、沸点が100℃以下の溶媒が50~100%であることが好ましくは、以好ましくは80~100%にある。沸点が100℃以下の溶媒が50%以下であると、乾燥速度が非常に遅くなり、進布面状が悪化し、進布膜厚にもムラが生じるため、反射率などの光学特性も悪化する。本発明では、沸点が100℃以下の溶媒を多く含む塗布液を用いる率により、この問題を解決した。

【0041】沸点が100℃以下の溶媒としては、例え ば、ヘキサン(沸点68.7℃、以下「℃」を省略す る)、ヘプタン(98.4)、シクロヘキサン(80. 7) . ベンゼン (80.1) などの炭化水素類、ジクロ ロメタン (39.8)、クロロホルム (61.2)、四 塩化炭素 (76.8) 、1,2-ジクロロエタン(8 5)、トリクロロエチレン(87.2)などのハロ ゲン化炭化水素類、ジエチルエーテル(34.6)、ジ イソプロピルエーテル(68.5)、ジプロビルエーテ ル(90.5)、テトラヒドロフラン(66)などのエ **一テル類、ギ酸エチル(54.2)、酢酸メチル(5** 7. 8) 、酢酸エチル (77. 1) 、酢酸イソプロビル (89) などのエステル類、アセトン (56.1)、2 ープタノン(=メチルエチルケトン、79.6)などの ケトン類、メタノール(64.5)、エタノール(7 8.3)、2-プロパノール(82.4)、1-プロパ ノール (97.2) などのアルコール類、アセトニトリ ル(81.6)、プロピオニトリル(97.4)などの シアノ化合物類、二硫化炭素(46.2)、などがあ る。このうちケトン類、エステル類が好ましく、特に好 ましくはケトン類である。ケトン類の中では2-ブタノ ンが特に好ましい。沸点が100℃を以上の溶媒として は、例えば、オクタン(125.7)、トルエン(11 O. 6) 、キシレン(138)、テトラクロロエチレン (121, 2)、クロロベンゼン(131, 7)、ジオ キサン(101.3)、ジブチルエーテル(142. 4)、酢酸イソブチル(118)、シクロヘキサノン (155.7)、2-メチル-4-ペンタノン (=MI BK、115.9)、1-ブタノール(117.7)、

ジメチルアセトアミド (166)、ジメチルスルホキシ ド (189)、などがある。好ましくは、シクロヘキサ ノン、2-メチル-4-ベンタノン、である。

【0042】本発明に係るハードコート層、低屈折率層 成分を前途の超成の溶媒で希釈することにより、それら の層用差布流が開製される。差布液濃度は、差布液の站 度、層素材の比重などを考慮して適宜関節される事が好 ましいが、0.1~20質量%が好ましく、より好まし くは1~10度量%である。

【0043】本発明の反射防止フィルムの透明支持体と

しては、プラスチックフィルムを用いることが好まし い。プラスチックフィルムを形成するポリマーとして は、セルロースエステル(例、トリアセチルセルロー ス、ジアセチルセルロース、代表的には富士写真フィル ム社製TAC-TD80U、TD80UFなど)、ポリ アミド、ポリカーボネート、ポリエステル(例、ポリエ **チレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート)、** ポリスチレン、ポリオレフィン、ノルボルネン系樹脂 (アートン:商品名、JSR社製)、非晶質ポリオレフ ィン(ゼオネックス:商品名、日本ゼオン社製)、など が挙げられる。このうちトリアセチルセルロース、ポリ エチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、 が好ましく、特にトリアセチルセルロースが好ましい。 トリアセチルセルロースは、単層または複数の層からな る。単層のトリアセチルセルロースは、特開平7-11 055号等で開示されているドラム流延、あるいはパン ド流延等により作成され、後者の複数の層からなるトリ アセチルセルロースは、公開特許公報の特開昭61-9 4725号、特公昭62-43846号等で開示されて いる、いわゆる共流延法により作成される。すなわち、 原料フレークをハロゲン化炭化水素類(ジクロロメタン 等、アルコール類(メタノール、エタノール、ブタノー ル等)、エステル類(蟻酸メチル、酢酸メチル等)、エ ーテル類(ジオキサン、ジオキソラン、ジエチルエーテ ル等)等の溶剤にて溶解し、これに必要に応じて可塑 剤、紫外線吸収剤、劣化防止剤、滑り剤、剥離促進剤等 の各種の添加剤を加えた溶液(ドープと称する)を、水 平式のエンドレスの金属ベルトまたは回転するドラムか らなる支持体の上に、ドープ供給手段 (ダイと称する) により流延する際、単層ならば単一のドープを単層流延 し、複数の層ならば高濃度のセルロースエステルドープ の両側に低濃度ドープを共流延し、支持体上である程度 乾燥して剛性が付与されたフィルムを支持体から剝離 し、次いで各種の搬送手段により乾燥部を通過させて溶 剤を除去することからなる方法である。

[0044]上記のような、トリアセチルセルロースを 溶解するための溶剤としては、ジクロロメタンが代表的 である。しかし地球環境や作業環境の観点から、溶剤は ジクロロメダン等のハロゲン化炭化水素を実質的に含ま 溶剤中のハロゲン化炭化水素の額合が5質量%未満(好ましくは2質量%未満)であることを意味する。ジクロ ロメタン等を実質的に含まない溶剤を用いてトリアセチ ルセルロースのドーブを調整する場合には、後途するような特殊な溶解法が必須となる。

[0045] 第一の落寮法は、冷却溶聚法と称され、以下に拠明する。まず室温近辺の温度(-10~40℃)で溶剤中にトリアセチルセルロースを授拝しながら徐々に返加する。次に、混合物は一100~10℃(好ましくは -80~10℃、表もに好ましくは一50~20℃、最も対ましくは一50~10℃。パーラン・水海したジェチレングリコール溶液(-30~20℃)や水却したジェチレングリコール溶液(-30~20℃)や水却したジェチレングリコール溶液(-30~10℃)に、これを0~20℃)を30℃(好ましくは0~150℃、56に大きはしくは0~150℃、56に対ましくは0~150℃。第州中にトリアセチルセルロースが流動する溶液となる。昇温は、室温中に放置するだけでもよし、温浴中で加温してもよい。

【0046】第二の方法は、高温溶解法と称され、以下 に説明する。まず室温近辺の温度(-10~40℃)で 溶剤中にトリアセチルセルロースを撹拌しながら徐々に 添加される。本発明のトリアセチルセルロース溶液は、 各種溶剤を含有する混合溶剤中にトリアセチルセルロー スを添加し予め膨潤させることが好ましい。本法におい て、トリアセチルセルロースの溶解濃度は30質量%以 下が好ましいが、フィルム製膜時の乾燥効率の点から、 なるべく高濃度であることが好ましい。次に有機溶剤混 合液は、0. 2MPa~30MPaの加圧下で70~2 40℃に加熱される(好ましくは80~220℃、更に 好ましく100~200℃、最も好ましくは100~1 90℃)。次にこれらの加熱溶液はそのままでは塗布で きないため、使用された溶剤の最も低い沸点以下に冷却 する必要がある。その場合、−10~50℃に冷却して 常圧に戻すことが一般的である。冷却はトリアセチルセ ルロース溶液が内蔵されている高圧高温容器やライン を、室温に放置するだけでもよく、更に好ましくは冷却 水などの冷媒を用いて該装置を冷却してもよい。ジクロ ロメタン等のハロゲン化炭化水素を実質的に含まないセ ルロースアセテートフィルムおよびその製造法について は発明協会公開技報(公技番号2001-1745、2 001年3月15日発行、以下公開技報2001-17 4.5号と略す)に記載されている。本発明の反射防止フ ィルムを液晶表示装置に用いる場合、片面に粘着層を設 ける等してディスプレイの最表面に配置する。該透明支 持体がトリアセチルセルロースの場合は偏光板の偏光層 を保護する保護フィルムとしてトリアセチルセルロース が用いられるため、本発明の反射防止フィルムをそのま

L١

【0047】本発明の反射防止フィルムは、片面に粘着 層を設ける等してディスプレイの最表面に配置したり、 そのまま偏光板用保護フィルムとして使用される場合に は、十分に接着させるためには透明支持体上に含フッ素 ポリマーを主体とする最外層を形成した後、鹼化処理を 実施することが好ましい。酸化処理は、公知の手法、例 えば、アルカリ液の中に該フィルムを適切な時間浸漬し て実施される。アルカリ液に浸漬した後は、該フィルム の中にアルカリ成分が残留しないように、水で十分に水 洗したり、希薄な酸に浸漬してアルカリ成分を中和する ことが好ましい。酸化処理することにより、最外層を有 する側とは反対側の透明支持体の表面が親水化される。 親水化された表面は、ポリビニルアルコールを主成分と する偏向膜との接着性を改良するのに特に有効である。 また、親水化された表面は、空気中の塵埃が付着しにく くなるため、偏向膜と接着させる際に偏向膜と反射防止 フィルムの間に座埃が入りにくく、塵埃による点欠陥を 防止するのに有効である。酸化処理は、最外層を有する 側とは反対側の透明支持体の表面の水に対する接触角が 40°以下になるように実施することが好ましい。更に 好ましくは30°以下、特に好ましくは20°以下であ る。

【0048】本発明の反射防止フィルムは以下の方法で 形成することができるが、この方法に制限されない。ま ず、各層を形成するための成分を含有した塗布液が調製 される。次に、ハードコート層を形成するための塗布液 を、ディップコート法、エアーナイフコート法、カーテ ンコート法、ローラーコート法、ワイヤーパーコート 法、グラピアコート法やエクストルージョンコート法 (米国特許2681294号明細書参照) により透明支 持体上に塗布し、加熱・乾燥するが、マイクログラビア コート法が特に好ましい。その後、光照射あるいは加熱 して、防眩性ハードコート層を形成するためのモノマー を重合して硬化する。これによりハードコート層が形成 される。ここで、必要であればハードコート層を複数層 とし、防眩性ハードコート層塗布の前に同様な方法で平 滑なハードコート層塗布および硬化を行うことができ る。次に、同様にして低屈折率層を形成するための塗布 液をハードコート層上に塗布し、光照射あるいは加熱し 低屈折率層が形成される。このようにして、本発明の反 射防止フィルムが得られる。

[0049] 本発明で用いられるマイクログラビアコー ト法とは、直径が約10~100mm、 好ましくは約2 0~50mmで全周にグラピアパターンが刻印されたグ ラピアロールを支持体の下方に、かつ支持体の搬送方向 に対してグラピアロールを逆回転させると共に、該グラ ピアロールの表面からドクターブレードによって余別の 参布津冬毎半落として、空星の釜布波を前取支持体の上 布液を転写させて塗工することを特徴とするコート法で ある。ロール形態の透明支持体を連続的に巻き出し、該 巻き出された支持体の一方の側に、少なくともハードコ ート層乃至含フッ素ポリマーを含む低层折率層の内の少 なくとも一層をマイクログラピアコート法によって塗工 することができる。

【0050】マイクログラビアコート法による塗工条件 としては、グラビアロールに刻印されたグラビアパター ンの線数は50~800本/インチが好ましく、100 ~300本/インチがより好ましく、グラビアパターン の深度は1~600μmが好ましく、5~200μmが より好ましく、グラビアロールの回転数は3~800 r pmであることが好ましく、5~200 rpmであるこ とがより好ましく、支持体の搬送速度は0.5~100 m/分であることが好ましく、1~50m/分がより好ま しい。このようにして形成された本発明の反射防止フィ ルムは、ヘイズ値が3~50%、好ましくは4~45% の範囲にあり、そして450nmから650nmの平均 反射率が2. 2%以下、好ましくは1. 9%以下であ る。本発明の反射防止フィルムが上記範囲のヘイズ値及 び平均反射率であることにより、透過画像の劣化を伴な わずに良好な防眩性および反射防止性が得られる。

[0051] 電光板は、電光膜を両面から狭く2枚の保 度フィルムで主に構成される。本発明の反射防止フィル ムは、電光膜を両面から挟た2枚の保度フィルムのうち 少なくとも1枚に用いることが好ましい。本架明の反射 防止フィルムが保護フィルムを要ねることで、電光地 製造コストを経滅できる。また、本発明の反射的 地力となるとなるとなるとなるとなる。 ルムを最表層に使用することにより、外光の映り込み等 が防止され、影像性、防汚性等も使れた電光板とするこ とができる。

20052] 個光膜としては公知の偏光膜や、偏光膜の 吸収輸が乗手方向に平行でも垂直でもない表見の偏光膜 から切り出された偏光膜を用いてもよい、角光膜の吸収 静秘長手方向に平行でも垂直でもない長尺の偏光膜 下の方法により作成さ両途を持手段により保持しつつ迷 ボリマーフィルムの両端を保持手段により保持しつつ迷 方向に1.1~20.0倍に延伸し、フィルム両端の保 持装蓋の乗手方向進行速度差が3%以内であり、フィアム 同様を保持する工程の出口におけるフィルムの両端の保 人両端を保持する工程の出口におけるフィルムの両端の保 と、フィルムの実質延伸方向のなす角が、20~70 ・傾斜するようにフィルム進行方向を、フィルム両端を 保持させた松原で屈曲させてなる延伸方法によって製造 保持させた松原で屈曲させてなる延伸方法によって製造

[0053] このような偏光膜の延伸方法は、(a)で 示される原反フィルム、例えば、ポリビールアルコール ポリマーフィルム、を矢印(イ)方向に導入する工程、 (b)で示される幅方向延伸工程、及び(c)で示され 含む。以下「延伸工程」と称するときは、これらの (a) ~ (c) 工程を含んで、延伸方法を行うための工 程全体を指す。フィルムは (イ) の方向から連続的に導 入され、上流側から見て左側の保持手段に目1点で初め て保持される。この時点ではいま一方のフィルム端は保 持されておらず、縦方向に張力は発生しない。つまり、 B1点は本発明の実質的な保持開始点(以下、「実質保 持翻始点」という)には相当しない。

[0055] この方法では、図2のようにAnはCnに対し次常に遅れてゆくため、延伸方向は、搬送方向垂直 から徐々に提続していく、実質的な保持解除。(以下、「実質保持解除点」という)は、より上流で保持手段から離設するCx点と、Cxから次工程へ送られるフィルムの中心線22に除重直で記りた直線が、反対で表すれる。最終的なフィルムの延伸方向の角度は、実質的な延伸工程の終点(実質供持解除点)での左右保持手段の行程差 ハース・(すむわち | しーし2 |)と、実質保持解除点の距離V(CxとAyの圧削)との比率で決まる。従 の工 延伸方向が次工程への搬送方向に対しなす傾斜角 ほ

tanθ=W/(Ay-Ax)、即ち、 tanθ=W/ | L1-L2 |

を満たす角度である。図2の上側のフィルム蟠は、Ay 点の後も28まで保持されるが、もう一端が保持されて いないため新たな幅方向延伸は発生せず、28は実質保 持解除点ではない。

【0056】以上のように、フィルムの両端にある実質 疾持開始点は、左右各々の保持手段への単純な噛み込み 点ではない。二つの実質集時開始点は、上記で定義した ことをより厳密に記述すれば、左右いずれかの保持点と 他の保持点とを結ぶ直線がフィルムを保持する工程に導 入さるラフィルムの中心線と略直交している点であり、 かつこれらの二つの保持点が最も上流に位置するものと して定義される。同様に、二つの実質保持解除点は、左 右いずれかの保持点と他の保持点とを観ぶ復進が、次工 程に送りだされるフィルムの中心線と略直交している点す であり、しかもこれら二つの保持点が最も下流に位置す であり、しかもこれら二つの保持点が最も下流に位置す エキュルトレーマ率まれる。こで、略阵交とは、フィル 解除点を結ぶ直線が、90±0.5°であることを意味 する。

[0087] テンター方式の延伸機を用いて左右の行星 差を付けようとする場合、レール長などの機械的制約に より、しばしば保持手段への動象込み点と実質保持開始 点に大きなずれが生じたり、保持手段からの離脱点と実 質保持限除点に大きなずれが生ずることがあるが、上記 定義する実質保持開始点と実質保持除点間の工程が式 (1)の関係を満たしていればよい。

【0058】上記において、得られる延伸フィルムにおける配向軸の傾斜角度は、(c) 工程の出口幅Wと、左右の二つの実質的保持手段の行程差 | L1-L2|の比率で制御、調整することができる。長手方向に対し、45°に近い配向角を得るためには、下配式(2)を満た

式 (2) 0.9W<|L1-L2|<1.1W さらに好ましくは、下記式 (3) を満たすことが好ましい。

すことが好ましく、

式(3) 0.97W<
|L1-L2|<1.03W
[0059] 亜伸工程へのフィルム導入方向(イ)と、
次工程へのフィルム搬送方向(口)のなす角度は、任意
の数値が可能であるが、延伸前後の工程を含めた腔偏の
総設置両接を最小にする観点からは、この角度は小さい
方がよく、3、以内が拝ましく、0.5・以内がさらに
好ましい。延伸率は1.1~10.0倍が望ましく、よ
り望ましくは2~10倍であり、その後の収縮率は10
%以上が望ましい。

【0060】また、延伸工程の影備コストを量小に抑え を観点から、保持手段の軌跡の周曲回数、居曲角度は かい程良い、この観点からは、図2に保宗する如くフィ ルム両端を保持する工程の出口におけるフィルムの進行 方向と、フィルムの実質延伸方向のなす角が、20~7 の・ 傾斜するようにフィルム連行方向をフィルム両端を 保持させた状態で思曲させることが好ましい。

[0061] テンター型の基件機の場合、クリップが固定されたチェーンがレールに沿って進む構造が多いが、本発明のように左右不均等な延伸方法をとると、結果的に図2[に例示される如く、工程入口、出口でレールの終端がずれ、左右同時に鳴み込み、離脱をしなくなることがある。この場合、実質工程長し1、 L2は、上に述べたように単純な噛み込み一種脱間の距離ではなく、既に述べたように、あくまでフィルムの両端を保持手段が保持している形分の行程長である。

[0062] 延伸工程出口でフィルムの左右に進行速度 差があると、延伸工程出口におけるシワ、客りが発生す るため、左右のフィルム把料手段の搬送速度離比、実質 的に同速度であることが求められる。速度差比対ましく は1%以下であり、さらに好ましくは0.5%未満であ り、最も新ましくは0.05%未満である。ここで述べ 除の長さのことである。一般的なテンター延伸機等では、チェーンを駆動するスプロケット歯の周期、駆動モータの周波数等に応じ、砂以下のオーダーで発生する速度ようがあり、しばしば数%のムラを生ずるが、これらは本発明で述べる速度差には該当しない。

【0063】また、左右の行程差が生じるに従って、フ ィルムにシワ、寄り、延伸軸のばらつきが発生する。こ の問題を解決するためには、ポリマーフィルムの支持性 を保ち、揮発分率が10%以上の状態を存在させて延伸 し、その後収縮させ揮発分率を低下させる。揮発分率と は、フィルムの単位体積あたりに含まれる揮発成分の体 積を表し、揮発成分体積をフィルム体積で割った値であ る。揮発分を含有させる方法としては、フィルムをキャ ストし溶剤・水を含有させる、延伸前に溶剤・水などに 浸漬・塗布・噴霧する、延伸中に溶剤・水を塗布するこ となどが上げられる。ポリビニルアルコールポリマーフ ィルムは、高温高湿雰囲気下で水を含有するので、高湿 雰囲気下で調湿後延伸、もしくは高湿条件下で延伸する ことにより揮発分を含有させることができる。これらの 方法以外でも、ポリマーフィルムの揮発分を10%以上 にさせることができれば、いかなる手段を用いても良 い。好ましい揮発分率は、ポリビニルアルコールでは揮 発分率として10%~100%が好ましい。

【0064】また、張伸ポリマーフィルムの収縮は、至 伸時、整伸後のいずれの工程でも行って良い。収縮によ り、斜め方向に配向する際の発生するポリマーフィルム のシワおよび延伸軸のばらつきが解消すればよく、フィ ルムを収縮させる手段としては、加熱することにより揮 発分を除去する方法などが挙げられるが、フィルムを 縮させればいかなる手段を用いても良い。好ましいフィ ルムの収縮率としては、長手方向に対する配向角のを用 いて、1/2 in 6倍以上収縮することで、値としては 10%以上収縮することが好ましい。

[0065] 斜め方向に配向する際の発生するボリマーフィルムのシワは、実質保持解除点までに消失していればよい。しかし、シワの発生から消失までに時間がかかると、延伸方向のばらつきが生じることがあり、好ましくは、シワが発生した地点からできるだけ短い移行距離でシワが消失することが良い。このためには、揮発分量の復発速度を高くするなどの方法がある。

【0066】 長尺、特にロール杉憩の個光膜を一貫工程 にて作数する場合には、染色のムラや抜けがないことが 必要である。 延伸前のフィルム中の揮発成が三分布のム ラ (フィルル面内の場所による揮発成分量の差異)があ ると染色ムラ、抜けの原因となる。従って、延伸前のフ イルム中の環発分成分の音分布は小さいほうが好まし く、少なくとも5%以下であることが好ましい、揮発分 率とは、フィルムの単位体積あたりに含まれる罹寒成分 の仕籍をあたらし、揮発療分体機をフィルム体構で割っ 変動幅 (平均揮発分率に対する、最大値または最小値と 該平均揮発分率との差の大きい方の比)を表す。 揮発分 成分の含有分布を小さくする方法として、フィルムの表 裏表面を均一なエアーでプローする、ニップローラーに て均一に較る、ワイバーなどで拭き取るなどが上げられ るが、分布が均一になればいかなる方法を用いても良

【0067】本発明の反射防止フィルムは、液晶表示装置(LCD)、プラズマディスプレイパネル(PD

- 置(LCD)、ブラズマディスプレイパネル(PD P)、エレクトロルミネッセンスディスプレイ(EL
- D) や陰極管表示装置(CRT)のような画像表示装置 に適用することができる。本発明の反射防止フィルムは 透明支持体を有しているので、透明支持体側を画像表示 装置の画像表示面に接着して用いられる。

【0068】本契明の反射防止フィルムは、個光酸の表面保護フィルムの片側として用いた場合、ツイステットネマチック(NTN)、スーティカルアライメント(VA)、インブレインスイッチング(IPS)、オプティカリーコンペンセイテットペンドセル(OCB)等のモードの透過型、反射型、または半透過型の液晶表示装置に好ましく用いることができる。

【0069】 V Aモードの液晶セルには、(1)棒状液 温性分子を電圧無知助性に実質的に垂直に配向させ、電 旺和助性に実質的に本年に配向させる映画のノモード の液晶セル(特開平2-176625号公報記載)に加 えて、(2)提野角拡大のため、VAモードをマルチド メイン化した(MV Aモードの) 浸量セル(59 7、Digest of tech. Papers(予稿集)28(199 7、Bigest of tech. Papers(予稿集)28(199 7)845記載)、(3)株状液温性分子を電圧無印力 防に実質的に重配向させ、電圧印即時にホセマルチ ドメイン配向させるモード(n-ASMモード)の液温 セル(日本浸温計論会の予模集58~59(1998) むり、および(4)SURVAIVALモードの浸温 ル(LCDインターナショナル98で発表)が含まれ

る。
【〇〇7〇】〇CBモードの液晶セルは、棒状液晶性分子を液晶セルの上部と下路とで実質的に逆の方向に(対称的に)配向させるペンド配向モードの液晶セルを用いた液晶表示装置であり、米国特計4583825号、同5410422号の各明機能と開示されている。棒状液晶性分子が液晶セルの上部と下部とで対称的に配向しているため、ペンド配向モードの液晶を上れば、自己光学補償機能を有する。そのため、この液晶モードは、〇〇C((Optically Compensatory Bend)液晶モードとも呼ばれる。ペンド配向モードの液晶表示装置は、応答速度が速いとの組合がある。

【0071】ECBモードの液晶セルでは、電圧無印加 時に棒状液晶性分子が実質的に水平配向しており、カラ 多数の文献に記載がある。例えば「EL、PDP、LCDディスプレイ」東レレサーチセンター発行(2001)などに記載されている。

[0072]特にTNモードやIPSモードの液晶表示 装置に対しては、特開2001-100043等に記載されてひまうた。 複野角拡大効果を有する光学補償フィルムを傷 光膜の裏套2枚の保護フィルムの内の木発明の反射防止 フィルムには反対側の面に用いることにより、1枚の傷 光板の厚みで反射防止効果と視野角拡大効果を有する偏 光板を得ることができ、特に好ましい。

【実施例】本発明を詳細に説明するために、以下に実施 例を挙げて説明するが、本発明はこれらに限定されるも のではない。

[0073]

(ハードコート層用途布液Aの調製) ジベンタエリスリトールベンタアクリレートとジベンタエリスリトール・サナクリレートの混合物 (DPHA、日本化業(株)製) 150gをメチルエデルケトン/シクロヘキサノン 50/50%の混合溶媒206gに溶解した。得られた溶液に、シリカブル30%メチルエテルケトン分散物 (MEKーST、日産化学社製、平均駐径列15mm)333g、光重含開始剤 (イルガキュア907、デバガイギー社製) 7.5gおよび光増懸剤 (カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製)5.0gを49gのメテルエチルケトンに溶媒した溶液を加えた。

[0074] (ハードコート層用差布液目の顕製) 市販 シリカ合有 U V硬化型ハードコート液 (デソライト 27 526、J S R社製、関移が過度 72%、シリカ含率 3 8%、平均粒径約 20 nm) 347g をメチルエテルケ トン/シクロヘキサノン=50/50%の混合溶媒 40 3g で希釈した。

[0075] (ハードコート暦用差布液での開製) 市販 アルミナ合有リV硬化型ハードコート液(デソライトK Z7951、JSR柱製、固形分濃度50%、アルミナ 合率50%、平均粒径約20nm)500gをメチルエ チルケトンンシクロヘキサノン=50/50%の混合溶 採250gで参照した。

【0076】 (ハードコート層用差布液Pの関数)ジベンタエリスリトールペンタアクリレートとジベンタエリ エリトールペンタアクリレートの混合物 (DPHA、日本化薬(株) 数) 250gをメチルエテルケトン/ンク ロヘキサノン=50/50%の混合溶媒 439gに溶解 した。得られた溶液に、光差を開始剤 (イルガキュア9 07、チバガイギー社製) 7、5gおよび光増密剤 (カ ヤキュアーDETX、日本化薬(株) 製) 5、0gを4 9gのメチルエチルケトン上溶解した溶液を加えた。 【0077】 (ハードコート層用塗布液Eの関数) 市販 シリカ合有 UV硬化型ハードコート流(デソライト) 26 26、18 R社製、固形/分離度72%、シリカ合率3 シプロピルトリメトキシシラン (KBM-5103信越 化学工業 (株) 製) を36g加え、この液をメチルエチ ルケトン/シクロヘキサノン=50/50%の混合溶媒 264gで希釈した。

[0078] (ハードコート層用差布液ドの翻製) 市販 アルミナ合有UV硬化型ハードコート液 (デリライトド フィ951、JSR社製、固部分選度50%、アルミナ 含率50%、平均粒径約20nm) 375gに3-アク リロキシブロビルトリメトキシシラン (KBM-510 3債越化学工業(株) 製) を47g加え、この液をメチ ルエチルケトン/シクロヘキサノン=50/50%の混 合業第328gで希釈した。

[0079] (ハードコート層用差布液のの観製) ジベンタエリスリトールペンタアクリルートシズペンタエリスリトールペンタアクリルートシズペンタエリスリトールへキサアクリルートの混合物 (DP HA、日本化薬(株) 製) 135gをメチルエチルケトン/シのした。得られた潜液に、シリガル300kg、平均粒色 約15nm) 300g、3-アクリロキシブロビルトリ製) を25g加え、光重合開始網 (イルガキュア907、チバガイギー社製) 7、5gおよび光増燃剤 (イルガキュア907、チバガイギー社製) 7、5gおよび光増燃剤 (カヤキュアーDETX、日本化薬(株) 製) 5、0gを設定のメチルエチルケトンに溶解した溶液を加えた。

【OO80】(防眩性ハードコート層用塗布液Aの調 製) 市販ジルコニア含有UV硬化型ハードコート液 (デ ソライト27401、JSR社製、固形分濃度48%、 ジルコニア含率71%、平均粒径約20nm) 278g にジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペン タエリスリトールヘキサアクリレートの混合物(DPH A、日本化薬(株)製) 117g、光重合開始剤(イル ガキュア907、チバガイギー社製) 7.5g、をメチ ルエチルケトン/シクロヘキサノン=50/50%の混 合溶媒355gで希釈した。この溶液を塗布、紫外線硬 化して得られた塗膜の屈折率は1.61であった。さら にこの溶液に平均粒径2 μmの架橋ポリステレン粒子 (商品名: SX-200H、綜研化学(株) 製) 10g を添加して、高速ディスパにて5000rpmで1時間 攪拌、分散した後、孔径30μmのポリプロビレン製フ ィルターでろ通して防眩性ハードコート層の塗布液Aを

[0081] (防蚊性ハードコート層用差布凝日の顕 製) 市販ジルコニア含有UV硬化型ハードコート液 (デ ソライト27401、JSR柱製、固形分裏度048 %、ジルコニア含率71%、平均粒径約20nm)52 1g、先重信開始剤 (イルガキュア907、デバガイギー 十世)7.5g、をメチルエチルケトンノシクロへキ サノン=50/50%の混合溶膜229gで密釈した。

調製した。

は1.73であった。さらにこの溶液に平均粒径2μm のベンソグナナミンーホルムアルギ(ド)樹脂粒子(商品 名:エボスター州S、日本機(体) 製) 10gを添加 して、高速ディスパにて5000rpmで1時間機件、 分散した後、私径30μmのポリプロピレン製フィルタ ーでろ適して防蚊性ハードコート層の塗布液Bを製製し た。

【0082】(防眩性ハードコート層用塗布液Cの調 製) ジベンタエリスリトールベンタアクリレートとジベ ンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物(DP HA、日本化薬(株)製) 75g、ピス(4ーメタクリ ロイルチオフェニル)スルフィド (MPSMA、住友精 化(株)製)75g、平均粒径33nmのアルミナ粒子 (シーアイ化成社製) 100gを、439gのメチルエ チルケトン/シクロヘキサノン=50/50%の混合溶 媒に溶解した。得られた溶液に、光重合開始剤(イルガ キュア907、チパガイギー社製) 5.0gおよび光増 感剤(カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製)3. 0gを61gのメチルエチルケトンに溶解した溶液を加 えた。この溶液を塗布、紫外線硬化して得られた塗膜の **屈折率は1.60であった。さらにこの溶液に平均粒径** 2 μ mの架構ポリスチレン粒子(商品名: SX-200 H、綜研化学(株) 製) 10gを添加して、高速ディス パにて5000 rpmで1時間攪拌、分散した後、孔径 30 µmのポリプロピレン製フィルターでろ過してハー ドコート層の塗布液Cを調製した。

【0083】(防眩性ハードコート層用塗布液Dの調 製) ジベンタエリスリトールベンタアクリレートとジペ ンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物(DP HA、日本化薬 (株) 製) 75g、ピス (4ーメタクリ ロイルチオフェニル)スルフィド(MPSMA、住友精 化(株)製)75g、平均粒径33nmのアルミナ粒子 (シーアイ化成社製) 100gを、439gのメチルエ チルケトン/シクロヘキサノン=50/50%の混合溶 媒に溶解した。得られた溶液に、3-アクリロキシプロ ピルトリメトキシシラン(KBM-5103信越化学工 業(株)製)28.7g、光重合開始剤(イルガキュア 907、チバガイギー社製) 5.0gおよび光増感剤 (カヤキュア-DETX、日本化薬(株)製) 3.0g を33gのメチルエチルケトンに溶解した溶液を加え た。この溶液を塗布、紫外線硬化して得られた塗膜の屈 折率は1.60であった。さらにこの溶液に平均粒径2 μmの架橋ポリスチレン粒子(商品名:SX-200 H、線研化学(株)製)10gを添加して、高速ディス パにて5000 rpmで1時間攪拌、分散した後、孔径 30 umのポリプロピレン製フィルターでろ過してハー ドコート層の塗布液Dを調製した。

 HA、日本化業(株)製)125g、ビス(4ーメタク リロイルデオフェニル)スルフィド(MPSMA、住友 精化(株)製)125gを、439gのメテルエテルケトン/シクロヘキサノン=50/50%の混合溶鉱にデ 解した。得られた溶液に、光重合開始剤(イルガキュア 907、ディバイギー社製)5.0gおよび光速密剤 (カヤキュアーDETX、日本化薬(株)製)3.0g を49gのメテルエデルケトンに溶解した溶液を加え た。この溶液と業布、紫外機をして得られた溶液を加え ボール・160であった。さらにこの溶液に平均粒径 μmの架構ポリスチレン粒子・個品名・SX ~ 200 パにて5000 rpmで1時間機件、分散した後、孔径 30μmのポリプロビン製フィルターでう遠してハー ドコート層の塗布液と変形とた場

【0085】(防眩性ハードコート層用塗布液Fの調 製)市販ジルコニア含有UV硬化型ハードコート液(デ ソライトZ7401、JSR社製、固形分濃度48%、 ジルコニア含率71%、平均粒径約20nm) 195g にジペンタエリスリトールペンタアクリレートとジペン タエリスリトールヘキサアクリレートの混合物(DPH A、日本化薬(株)製) 82g、3-アクリロキシプロ ピルトリメトキシシラン(KBM-5103信越化学工 業 (株) 製) 45.8g、光重合開始剤 (イルガキュア 907、チバガイギー社-製) 7.5g、をメチルエチ ルケトン/シクロヘキサノン=50/50%の混合溶媒 348gで希釈した。この溶液を塗布、紫外線硬化して 得られた塗膜の屈折率は1.59であった。さらにこの 溶液に平均粒径2 μ mの架橋ポリスチレン粒子(商品 名: SX-200H、綜研化学(株)製) 10gを添加 して、高速ディスパにて5000rpmで1時間攪拌、 分散した後、孔径30μmのポリプロピレン製フィルタ 一でろ過して防眩性ハードコート層の塗布液Fを調製し t--

【00861 (防眩性ハードコート層用業布液 Gの調整) 市販ブルコニア含有 DV 侵化型ハードコート液 (デソライト Z7 401、JS R社製、固形分濃度 48%、ジルコニア含率 71%、平均敏径約20nm) 250g にジベンタエリスリトールペンタアクリレートとジベンタエリスリトールペキサアクリレートの混合的 [DPH A、日本化薬(株)製)105g、3-アクリロキンデェ業(株)製)258g、3-アクリロキンデェ業(株)製)258g、3-アクリロキンデェ等(株)製)258g、3-アクリロキンデッカンド、(大)ガイギー社製)7、5g、をメチルエデリス・アリス・ディガイギー社製)7、5g、をメチルエデリルケトン/シクロヘキサ/ン=50/50%の混合を表生布、紫外接硬化して得られた生製の屋折率は1、61であった。さらにこの溶液に平均粒径 2 μmの業様ボリスチレン粒子(商品名・SX-200H、線研化学(株)製)10gを添加

分散した後、孔径30μmのポリプロピレン製フィルターでろ過して防眩性ハードコート層の塗布液Gを調製した。

【0087】(防蚊性ハードコート層用塗布液日の類型) 上記、防蚊性ハードコート層用塗布液Gの3 - アクリロキシブロビルトリメトキシシラン (KBM-5103信越化学工業(株) 製) を、アーグリシドキシブロビルトリメトキシシラン (KBM-403信越化学工業(株)製) に変更した以外は、添加量も含め上記塗布液区と全く同様にして防蚊性ハードコート層用塗布液Hを調製した。

[0088] (防眩性ハードコート層用差布液1の調 製) 上記、防眩性ハードコート層用差布液6の3-アク リロキシブロビルトリメトキシシラン (KBM-510 3信銘化学工業 (株) 製) を、アーメタクリロキシブロ ビルトリメトキシシラン (KBM-503信経化学工業 (株) 製) に変更した以外は、添加量も含め上記差布液 医と全く同様にして防眩性ハードコート層用差布液 Iを 調製した。

[0088] (防眩性ハードコート層用差布液 Jの関
製) 上記、防眩性ハードコート層用差布液 Gの3 アクリロキシブロビル・リメトキシシラン (KBM - 510 3 信越化学工業(株)製)を、オルトけい酸テトラエテル(和光純素(株)製)で変更した以外は、添加量も含め上記差布液 Gと全く同様にして防眩性ハードコート層用差布液 Jを開墾した。

【0090】(防咳性ハードコート層用塗布液 Kの調 勢) ジベンタエリスリトールペンタアクリレートとジベ ンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物 (D P H A、日本化薬 (株) 製) 91g、粒径約30nmの酸 化ジルコニウム超微粒子分散物含有ハードコート塗布液 (デソライト2 7 4 0 1、J S R (株) 製) 218g を、52gのメチルエチルケトングシクロヘキサイン= 54/46質量外の混合溶剤に治解した。得られた治液 に、光重色開始剤 (イルガキエア907、デバファイン ケミカルズ (株) 製) 10gを加え、機件溶解した後ル に、20質量パーセントの含フツ素オリゴマーのメモナル エチルケトン溶液からなるフツ素素剤面に性剤 (メガフ アックドー176PF、大日本インキ (株) 製) 0. 93gを添加した。この溶液を塗布、紫外線硬化して得 られた塗板の既形率は、61であった。

【0091】さらにこの溶液に個数平均粒径1.99μm、粒径の標準偏差0.32μm(個数平均柱径016%)の架構ポリステレン粒子(商品名:SX-200HS、終研化学(株)製)20gを80gのメチルエチルケトン/シクロヘキサ/ン=54/46質量%の混合溶剤に高速ディスパにて5000rpmで1時間機斧分数し、孔径10μm、3μmのポリプロピレン製フィルター(それぞれPPE-10、PPE-03、P

ろ過して得られた分散液29gを添加、攪拌した後、孔 径30μmのポリプロピレン製フィルターでろ過して防 眩性ハードコート層塗布液Kを調製した。

【0092】(防眩性ハードコート層用塗布液しの調) ジベンタエリスリトールベンタアクリレートとジベ ンタエリスリトールヘキサアクリレートの混合物(DP HA、日本化薬(株)製)82g、粒径約30nmの酸 化ジルコニウム超微粒子分散物含有ハードコート塗布液 (デソライトZ-7401、JSR(株) 製) 196 g、3-アクリロキシプロビルトリメトキシシラン(K BM-5103信越化学工業(株)製)20.7g、 を、64.5gのメチルエチルケトン/シクロヘキサノ ン=54/46質量%の混合溶剤に溶解した。得られた 溶液に、光重合開始剤(イルガキュア907、チバファ インケミカルズ(株)製)10gを加え、攪拌溶解した 後に、20質量パーセントの含フッ素オリゴマーのメチ ルエチルケトン溶液からなるフッ素系界面活性剤(メガ ファックF-176PF、大日本インキ(株)製) O. 93gを添加した。この溶液を塗布、紫外線硬化し て得られた塗膜の屈折率は1、61であった。さらにこ の溶液に個数平均粒径1、99 μm、粒径の標準偏差 O. 32 µm (個数平均粒径の16%) の架橋ポリスチ レン粒子 (商品名: SX-200HS、綜研化学 (株) 塑) 20gを80gのメチルエチルケトン/シクロヘキ サノン=54/46質量%の混合溶剤に高速ディスパに て5000rpmで1時間攪拌分散し、孔径10 mm、 3 μm、1 μmのポリプロピレン製フィルター(それぞ れPPE-10、PPE-03、PPE-01、いずれ も富士写真フイルム(株)製)にてろ過して得られた分 散液29gを添加、攪拌した後、孔径30μmのポリブ ロビレン製フィルターでろ過して防眩性ハードコート層 塗布液しを調製した。

【0093】(筋眩性ハードコート層用差布液Mの調 製) フッ素系界面活性剤をシリコーン系界面活性剤(シ リコーン×ー22-945、個越化学工業(株)製)に 富き換えた以外は防眩性ハードコート層差布液火と同様 にして、防旋簾用差布液Mを開製した。

【0094】(防眩性ハードコート層用塗布液Nの調 製) フリ素系界面活性剤をシリコーン系界面活性剤(シ リコーンメー22-945、信館化学工業(株)製)に 富き換えた以外は防眩性ハードコート層塗布液しと同様 にして、防眩層用塗布液化を開製した。

【0085】 (防駄性ハードコート層用塗布炭イの調 製) 市販・リカ含有 UV硬化型ハードコート液(デソラ イトK 2 7 3 1 7、 J S R 社製、固形分濃度約 7 2 %、 関形分中 S 1 0 2 6 率約 3 8 %、重合性モノマー、重合 開始剤含有) 2 7 2 g をメデルインブチルケトン 2 6 . 2 g で希別 L 6 . この溶液を塗布、紫外種便化 して得ら れた塗膜の屈折率は 1.51であった。さらにこの溶液 名:SX-350H、輪扇化学(株)型)の25%メチルイソブチルケトン分散液をポリトロン分散機にて10000rpmで30分分散した分散液を44度加え、次いで、平均粒径5μmの架橋ポリスチレン粒子(商品名:SX-500H、輸駅化学(株)型)の25%メチルイソブチルケトン分散液をポリトロン分散機に10000rpmで30分分散した分散液を57.8g加えた。上記混合液を孔径30μmのポリブロビレン型フィルターで5減して防陸性ハードコート層の塗布液イを調製した。

【0096】(防眩性ハードコート層用塗布液口の調 製) 市販シリカ含有UV硬化型ハードコート液 (デソラ イトKZ7317、JSR社製、固形分濃度72%、固 形分中SiO2含率約38%、重合性モノマー、重合開 始剤含有)245gに3-アクリロキシプロピルトリメ トキシシラン(KBM-5103信越化学工業(株) 製) 19. 6gを加え、さらにメチルイソプチルケトン 33.6gで希釈した。この溶液を塗布、紫外線硬化し て得られた塗膜の屈折率は1.51であった。さらにこ の溶液に平均粒径3.5 µmの架橋ポリスチレン粒子 (商品名: SX-350H、綜研化学(株)製)の25 %メチルイソブチルケトン分散液をポリトロン分散機に て10000rpmで30分分散した分散液を44g加 え、次いで、平均粒径5 µmの架橋ポリスチレン粒子 (商品名:SX-500H、綜研化学(株)製)の25 %メチルイソブチルケトン分散液をポリトロン分散機に て10000rpmで30分分散した分散液を57.8 g加えた。上記混合液を孔径30μmのポリプロビレン 製フィルターでろ過して防眩性ハードコート層の塗布液 口を調製した。

[0097] (防眩性ハードコート層用塗布液への調 製) 上記、防眩性ハードコート層用塗布液ロの3-アク リロキシブロビルトリメトキシシラン (KBM-510 3信銘化学工業 (林) 製) を、ァーグリシドキシブロビ ルトリメトキシシラン (KBM-403信銘化学工業 (株) 製) に変更した以外は、添加量も含め塗布液口と 全く同様にして防眩性ハードコート層用塗布液ハを調製 した。

【0088】(防眩性ハードコート層用塗布液ユの関 製)上記、防眩性ハードコート層用塗布液口の3-アク リロキシプロビルトリメトキシシラン(KBM-510 3億略化学工業(株)製)を、オルトけい酸テトラエチ ル(和光純素工業(株)製)に変更した以外は、添加量 も含め塗布液口と全く同様にして防眩性ハードコート層 用塗布液こを観製した。

【0099】(防眩性ハードコート層用塗布液木の調 差)上記、防眩性ハードコート層用塗布液口の3-アク リロキシブロピルトリメトキシシラン(KBM-510 3信該化学工業(株)数)を、アーメタクリロキシブロ (株)製)に変更した以外は、添加量も含め塗布液口と 全く同様にして防眩性ハードコート層用塗布液ホを調製 した。

[0100] (低展折率層用差布液Aの調整) 展折率
1. 42の熱架機性含フッ素ポリマー (JN-722
カゾル (MEKーST、平均転径10~20nm、固形 分濃度30%、日産化学社製) 15. 2gおよびメチル エチルケトン116g、シクロヘキサノン9. 0gを添 加、機件の後、孔径1μmのポリプロピレン製フィルターでろ進して、低展折率層用差布液を調製した。

一でろ過して、低屈折率雇用差布液を調製した。 【0101】 (低屈折率雇用差布液Bの調製) 屈折率 1. 40の影架構性含フッ素ポリマー (JN-722 3、園影分選度6%、JSR (装) 製) 177gに平均 粒径30nmのフッ化マグネシウム粒子4. 6g および メチルエチルケトン126. 6g、シクロへキサノン 9. 0gを添加、攪拌の後、飛径5μmのポリプロピレン製フィルターでろ過して、低屈折率雇用差布液を調製 した。

【0102】(低屈折率層用塗布液Cの調製)屈折率 42の熱架橋性含フッ素ポリマー(JN-722) 8、固形分遺度 6%、JSR(株)製) 2 4 5 g にメチ ルエチルケトンを63.2g、シクロヘキサノン9.0 g添加、攪拌の後、孔径1µmのポリプロピレン製フィ ルターでろ過して、低屈折率層用塗布液を調製した。 【0103】(低屈折率層用塗布液Dの調製) 屈折率 42の熱架橋性含フッ素ポリマー(JN-722) 8、固形分濃度 6%、JSR (株) 製) 177g にシリ カゾル (MEK-ST、平均粒径10~20nm、固形 分濃度30%、日産化学社製)15.2g、3ーアクリ ロキシプロピルトリメトキシシラン(KBM-5103 信越化学工業(株)製)29.3gおよびメチルエチル ケトン95g、シクロヘキサノン9.0gを添加、攪拌 の後、孔径1μmのポリプロピレン製フィルターでろ過 して、低屈折率層用塗布液を調製した。

[0104] (低風折率層用途布液圧の調整)上記、低 掘折率層用塗布液Dの3-アクリロキシプロビルトリメ トキシシラン (KBM-5103価能化学工業(株) 憩) 29.3 gの量を19.5 gに変更した以外は低風 折率層用途布液Dと全く同様にして低風折率層用塗布液 変調製した。

【0105】(低挺折率勝用塗布液Fの調整)上記、框 掘折率陽用塗布液Dの3-アクリロキシプロビルトリメ トキシシラン(KBM-5103億越化学工業(株) 製)を、アーグリシドキシプロビルトリメトキシシラン (KBM-403億越化学工業(株)製)で乗りた以 外は添加量も含めて低限折率層用塗布液Dと全く同様に

して、低屈折率層用塗布液を調製した。 【0106】(低屈折率層用塗布液Gの調製)上記、低 トキシシラン (KBM-5103信銭化学工業(株) 数)を、アーメタクリロキシブロビルトリメトキシラン ン (KBM-503信銭化学工業(株) 数)に変更した 以外は添加量も含めて低屈折率層用差布液Dと全く同様 にして、低屈折率層用を布液を観影した。

【0107】 (低眠折率層用途布液Hの調製) 屋上記、 低低折率層用途布液Dの3-アクリロキシプロビルトリ メトキシシラン (KBM-5103信途化学工業(株) 製) を、オルトけい酸テトラエチル (和光純薬(株) 製) に変更した以外は添加量も含めて低度析率層用塗布 液Dと全く同様にして、低层折率層用塗布液を調製し た。

[0108] (低屁折率原用途布波1の調整) 屈折率
1.40の熱架構性含フッ素ポリマー(JN-722
3、脚形分速度6%、JSR(株) 製) 177度に平均 粒径30nmのフッ化でグネシウム粒子4.6g、3-70リロキシブロビルトリメトキシシラン (KBM-5
103億粒倍学工業(株) 製) 29.3gおよびメチルエチルケトシ106g、シクロヘキサノン9.0gを蒸加、機体の後、孔径の、mのポリブロビン製フィルターでる進して、低肥折率原用差去液を調製した。

[0109] [実施例1] ハードコート層A~G、防弦 性ハードコート層A~N、低風折率層A~1 それぞれを 以下のようにして釜布した。積層の組み合わせは表1、 素2に記載のとおりに行った。

(1) ハードコート層の塗設

80μmの厚さのトリアセチルセルロースフイルム(T AC-TD80以、富士写真フイルム(株) 製)をロール形態で巻き出して、上記のハードコート層用差布液を 機数 180 ホ/インチ、深度 40μmのグラビアパター ンを有する直径50mmのマイクログラビアルター クターブレードを用いて、グラビアロール回転数30ァ pm、搬送速度10m/分の条件で塗布し、120℃、 2分で数複句後、能素速度0、1%以下の窒素パージ下 で160W/cmの空冷メタルハライドランプ (アイグ ラフィックス (株) 製) を用いて、照度400mW/c m²、照射量30の加ノ cm²の業外線を照射して塗布 層を硬化させ、厚さ2.5μmのハードコート層を形成 し、巻き取った。

[0110] (2) 防旋性ハードコート層の塗設 該ハードコート層を塗敷したトリアセテルセルロースフ イルムを再び巻き出して、上記の防眩性ハードコート層 用塗布液を線数180ネ/インチ、深度40μmのグラ ピアパターンを有する直径50mmのマイクログラピア ロールとドクターブレードを用いて、グラピアロール回 転数30rpm、搬送速度5m/分の条件で塗布し、1 20でセ分対途の後、窒素パージ下で160W/cm の室角メタルバライドラング「アイグラフィックス (挨) 製) を用いて、照度400mW/cm²、照射量 300mJ/cm²の紫外線を照射して塗布層を硬化さ せ、厚さ2.5μmの防眩性ハードコート層を形成し、 巻き取った。

【0111】(3)低屈折率層の塗設

該ハードコート層と防蚊性ハードコート層を建設したトリアセチルセルロースフイルムを再び巻き出して、上記 低屈折率展用接布液を線数 18 0本/インチ、深度 4 0 μmのグラピアパターンを有する直径50mmのマイク ログラピアロールとドクターブレードを用いて、グラピアロールの製30 1 pm、送速度10m/分の条件で塗布し、80℃で2分乾燥の後、さらに重素パージ下で240W/cmの空赤メタルハライドランプ(アイヴァンマクス(は) 刻 を用いて、照底400mW/cm²、照射量300mJ/cm²の紫外線を照射し、140℃で10分間熱架構し、厚さ0.096μmの低屈折 実備をお嫁れ、米考取った。

[0112]

【表1】

\$C\$\$No.	ハードコート雇用 塗布液	防蚊性ハードコート 用集布兼	低屈折率層用曲布被	
101 (比較例)	なし	A	A	
102 (比較例)	なし	В	A	
- 103 (比較例)	なし	С	A	
104 (本発明)	₽L.	D	A	
105 (比較例)	なし	E	٨	
106 (本発明)	なし	F	A	
107 (本発明)	なし	O-	A	
108 (本発明)	なし	H	A	
109 (本発明)	なし	I	A	
110 (本発明)	⊉ L	J	A	
111 (比較例)	幸し	K	A	
112 (本発明)	なし	ь	A	
113 (比較例)	なし	м	A	
114 (本発明)	⊉ù	N	A	
115 (比較例)	A	A	A	
116 (比較例)	В	A	A	
117 (比較例)	C	A	A	
118 (比較例)	D	A	A	
119 (本発明)	E	A	A	
120 (本発明)	F	A	Α	
121 (本発明)	G	A	A	
122 (比較例)	В	A	В	
123 (比較例)	В	٨	C	
124 (本発明)	В	A	D	
125 (本発明)	В	A	E	
126 (本発明)	В	A	F	
127 (本発明)	В	Α	G-	
128 (本発明)	В	A	H	
129 (本発明)	В	A	I	
130 (本発明)	E	A	D	
131 (本発明)	E	A	E	
132 (本発明)	В	A	F	
133 (本発明)	E	F	A	

[0113]

[表2]

	194 = 2							
BERSHO.	ハードコート雇用 塗布液	防弦性ハードコート 用性布液	低風折率層用塗布被					
134 (本発明)	E	G	A					
135 (本発明)	E	H	A					
136 (本発明)	E	Q.	D					
137 (本発明)	E	Q.	E					
138 (本発明)	В	F	D					
139 (本発明)	В	0	D					
140 (本発明)	В	G	E					
141 (本発明)	В	H	F					
142 (本発明)	В	J	H					
143 (比較例)	В	K	A					
144 (本発明)	В	L	A					
145 (比較例)	В	м	Α					
146 (本発明)	В	N	A					
147 (本発明)	なし	G	D					
148 (本発明)	なし	G	E					
149 (本発明)	なし	G	H					
150 (比較例)	D	E	C					
151 (本発明)	E	G	D					
152 (* ANRII)	P	J	H					

眩性ハードコート層まで塗布した試料について、表面エ ネルギーと、X線光電子部分光法で測定したフッ素原子 由来のピークと炭素原子由来のピーク比F/Cと、シリ コン原子由来のピークと炭素原子由来のピーク比Si/

[O 1 1 4] 上記試料の中から抜粋した試料について防 Cを以下に示す。なお、防眩性ハードコート層の表面エ ネルギーは、純水およびジョードメタンの接触角を測定 してOwensの表面エネルギーの式に代入して算出し t.

> 試料116:表面エネルギー 22mN·m⁻¹、 F/C 0.53 試料143:表面エネルギー 31mN・m-1、 F/C 0.28

試料145:表面エネルギー 29mN·m⁻¹、 Si/C 0.12 試料146:表面エネルギー 30mN・m-1、 Si/C 0.11

【0115】(反射防止膜の評価)得られたフィルムに

ついて、以下の項目の評価を行った。

た後、HEIDON-14動摩擦測定機により5mmの

ステンレス鋼球、荷重100g、速度60cm/min

(1) 平均反射率 分光光度計 (日本分光 (株) 製) を用いて、380~7 80 nmの波表領域において、入射角5°における分光 反射率を測定した。結果には450~650 nmの平均 反射率を用いた。 (2) ヘイズ 情もたフィルムのヘイズをヘイズメーターMODEL 1001DP (日本電色工業 (株) 製) を用いて測定	
8 0 n m の波長領域において、入射角 5 ° における分光 反射率を測定した。結果には 4 5 0 ~ 6 5 0 n m の平均 反射率を用いた。	
反射率を測定した。結果には 4 5 0 ~ 6 5 0 n mの平均 灯 (8 0 0 0 c d / m²) を映し、その反射像のポケの 反射率を用いた。 (2) ヘイズ 保られたフィルムのヘイズをヘイズメーターM O D E L 蛍光灯の輪郭がわずかにわかる : ○	
反射率を用いた。 程度を以下の基準で評価した。 (2) ヘイズ 第出がの権事が全くわからない 第出がの権事が全くわからない 第出がの権事が分ずがにわかる : ○	
(2) ヘイズ <u> </u>	
得られたフィルムのヘイズをヘイズメーターMODEL 蛍光灯の輪郭がわずかにわかる :○	
1001DP (日本電色工業(株) 製)を用いて測定 蛍光灯はぼけているが、輪郭は識別できる : △	
した。	
(3) 鉛筆硬度評価 (7) ギラツキ評価	
耐傷性の指標としてJIS K 5400に記載の鉛筆 作成した防眩性フィルムにルーパーありの蛍光灯拡散光	5
硬度評価を行った。反射防止膜を温度25℃、湿度60 を映し、表面のギラツキを以下の基準で評価した。	
%RHで2時間調湿した後、JIS S 6006に規 ほとんどギラツキが見られない : 〇	
定する3 Hの試験用鉛筆を用いて、1 kgの荷重にて わずかにギラツキがある : △	
n=5の評価において傷が全く認められない : O 目で識別できるサイズのギラツキがある : ×	
n=5の評価において傷が1または2つ : Δ 【0117】(8) スチールウール耐傷性評価	
n=5の評価において傷が3つ以上 :× ラビングテスターを用いて、以下の条件でこすりテスト	
(4)接触角、指紋付着性評価 をおこなった。	
表面の耐汚染性の指標として、光学材料を温度25℃、 試料調湿条件: 25℃、60%RH、2時間以上。	
湿度60%RHで2時間潤湿した後、水に対する接触角 こすり材: 試料と接触するテスターのこすり先端部	
を測定した。またこのサンプル表面に指紋を付着させて (1cm×1cm)にスチールウール(日本スチールウ	,
から、それをクリーニングクロスで拭き取ったときの状 一ル製、ゲレー FNo. 0000) を巻いて、動かないよ	
態を観察して、以下のように指紋付着性を評価した。 うパンド固定した。	
指数が完全に拭き取れる : O 移動距離(片道): 13 cm、 こすり速度: 13 c	;
指紋がやや見える : Δ m/秒、 荷重:200g/cm ² 、 先端部接触面	
指紋がほとんど拭き取れない :× 積:1cm×1cm、 こすり回数:10往復。	
【0116】(5)動摩擦係数測定 こすり終えた試料の裏側に油性黒インキを塗り、反射が	E
表面滑り性の指標として動摩擦係数にて評価した。動摩で目視観察して、こすり部分の傷を、以下の基準で評価	li .
擦係数は試料を25℃、相対湿度60%で2時間調湿し した。	
非常に注意深く見ても、全く傷が見えない。 : ©	
非常に注意深く見ると僅かに弱い傷が見える。 : 〇	
弱 い傷が見える。 : ○△	
中程度の傷が見える。 : △	
ー目見ただけで強い傷が見える。 : ×	
【O118】(9)水綿棒こすり耐性評価 30~50往復で膜剥がれ △	
ラビングテスターのこすり先端部に綿棒を固定し、平滑 50~100往復で襲剝がれ ○△	
皿中で試料の上下をクリップで固定し、室温 25℃で、 100~150往復で膜剥がれ O	
試料と綿棒を25℃の水に浸し、綿棒に300gの荷重 150往復でも膜剥がれなし ◎	
をかけて、こすり回数を変えてこすりテストを行った。 【0119】(10)塗布面状ムラ	
こすり条件は以下のとおり。 塗布面側を上にして、裏面側から上記蛍光灯を照射し	
こすり距離(片道):1cm、 こすり速度:約2柱 て、透過目視面検にてハジキ、ブツ等の点欠陥、塗布。	
復/秒 ラ、乾燥ムラ等の面状ムラの発生頻度について、10m	
こすり終えた試料を観察して、膜剥がれが起こった回数 2だけ検査し、その値を10で割って1m ² 当たりの面	犬
で、こすり耐性を以下のように評価した。 ムラの数を算出した。	
○ ~ 1 ○ 往復で膜剝がれ × 【 O 1 2 O 】上記試料中の本発明の試料において、指統	玟

対防止性能と鉛筆硬度も防眩性反射防止フィルムに必要とされる性能レベルを越えていた。また試料116、143~146について面状ムラの数を勢また。

試料116 9個/m² 試料143 3個/m² 試料144 0個/m² 試料145 3個/m² 試料146 1個/m²

その結果、ハードコート層に本発明の界面活性剤を含有 することにより差布面状ムラ低減効果が確認された。そ の他の評価結果について表3、4に示す。本発明の試料 104、106~110、112、114、119~1 21、124~142、144、146~149、15 1、152は、比較例試料101~103、105、1 11、113、115~118、122、123、14 3、145、150に比べて、ステールウール耐傷性と 結棒にすり性能が優れていることが分かる。特に、防ち物 を含有した系が耐傷性能に使れることが分かる。これら の効果は木発明のシラン系化合物の含有によることが明 らかである。 [0121]

【表3】

欧科斯	平均反射	ヘイズ (%)	鉛筆便度	接触角。	動學療術數	びー約・4階 傷性	総件こすり
01 (比較例)	2.1	12.2	0	102	0.08	×	х
02 (比较例)	2.1	12.6	0	102	0.07	×	×
03 (比較例)	2.1	13.2	0	103	0.08	×	×
04 (本発明)	2.0	11.6	0	102	0.08	0	0
05 (比較例)	2.2	128	Δ	102	0.08	×	×
06 (本発明)	2.0	13.0	0	102	0.08	0	0
07 (本発明)	2.1	13.2	0	102	0.08	0	0
08 (本発明)	1.9	13.3	0	101	0.08	ΟΔ	ΔΟ
09 (本発明)	2.1	12.2	0	102	6.08	ΔΟ	0
10 (本発明)	1.9	13.1	0	102	0.08	0	ΔΟ
11 (比較例)	2.1	12.8	0	102	0.08	×	×
12 (本発明)	2.0	13.0	0	101	0.08	0	0
13 (比較例)	2.1	12.2	0	100	0.05	×	×
14 (本発明)	2.1	12.5	0	100	0.08	0	0
15 (比較例)	2.1	16.2	0	102	0.08	×	×
16 (比較例)	2.0	15.1	0	102	0.98	×	×
17 (比較例)	2.1	15.8	0	102	0.08	×	×
18 (比較例)	2.2	14.0	Δ	102	0.07	×	X
19 (本発明)	2.1	15.2	0	102	0.08	0	0
20 (本発明)	2.1	15.6	0	101	0.08	10	0_
21 (本発明)	2.1	16.2	0	102	0,08	0	0
22 (比較例)	2.2	15.1	4_	102	0.08	×	×
23 (比較例)	2.1	14.6	Δ	102	9.08	×	×
24 (本発明)	2.0	16.2	Δ	102	0.08	0	0
25 (本発明)	2.1	15.2	Δ	103	0.08	0_	ΔΟ
26 (本発明)	1.9	15.6	Δ	102	0.08	ΟΔ	ΔΟ
27 (本発明)	2.1	16.2	Δ_	101	0.03	- ΔΟ	_ ΔΟ
128 (本発明)	2.0	15.5	Δ	102	0.08	0	0
129 (本発明)	2.1	15.8		102	0.08	-	0
130 (本発明)	2.0	16.0	0	102	0.07	0	0
131 (本発明)	1.9	15.2	0	102	0.08	0	0
32 (本発明)	2.1	15.5	0	101	80_0	ΔΟ	04
33 (木発明)	2.1	16.2	0	102	0.08	0	0
134 (本発明)	2.0	15.1	0	101	0.08	0	0

[0122] [表4]

紅料施	平均反射	ヘイズ	齡等更度	接触角"	動摩擦係数	びーめー 浦	物棒とすり
	*(X)	(%)				傷性	
135 (本髡明)	2.1	15.8	0	102	0.08	0	0
136 (本発明)	2.2	16.1	0	102	0.08	0	0
137 (本発明)	2.1	15.2	0	102	0.08	0	0
138 (本発明)	2.1	15.6	0	102	8.09	0	0
139 (本発明)	1.9	16.2	0	103	0.08	0	0
140 (本発明)	2.1	15.2	0	102	0.08	0	0
141 (本発明)	2.1	15.B	0	101	0.08	0	0
142 (本発明)	2.0	16.0	0	102	0.08	0	0
143 (比較例)	2.1	15.4	0	103	0.06	×	×
144 (本発明)	2.1	15.6	0	102	0.08	0	0
145 (比較例)	2.1	16.3	0	102	90.0	×	×
146 (本発明)	1.9	15.1	0	103	0.87	0	0
147 (本発明)	2.1	15.8	0	102	0.06	0	0
148 (本発明)	2.0	16.0	0	102	0.08	9	0
149 (本発明)	2.1	16.2	0	101	0.08	0	0
150 (比較例)	2.2	7.1	Δ.	102	0.06	×	Χ.
151 (本発明)	2.1	16.0	0	102	0.08	0	0
152 (本発明)	2.1	15.9	0	101	0.08	0	0

【0123】次に、未免期の試料104、106~11 0、112、114、119~121、124~14 2、144、146~148、151、152のフィル ムを用いて防乾性反射防止偏光振を作成した。この個先 を存して反射防止陽を最表層に配置した液晶表示装置 を作製したところ、外光の映り込みがないために優れた コントラストが得られ、防眩性により反射像が目立たず本 発明の試料を観光子、透明支持体およびディスコティック 液晶の配向を固定した光学果方層から構成される光学 わせて液温表子養置を作製した光学 力せて液温表子養置を作製して設定を存極したとこ ろ、外光の映り込みがなく、優れたコントラストが得られ れ、防眩性により反射像が目立たず優れた性能を有して いた。

【0124】 (反射防止フィルムの飲化規理) 前配試料 101~152について、以下の処理を行った。1.5 Nの水酸化ナトリウム水溶液を調製し、50℃に保湿した。0.0 Nの希磁能水溶液を調製した。件製した皮 財防止フィルムを上部の水酸化ナトリウム水溶液に2分 間浸漬した後、水に浸漬し水酸化ナトリウム水溶液を十分に洗い液した。次いで、上配の希磁能水溶液上1分間 浸漬した後、水に浸漬し米酸水溶液を十分に洗い流した。さらに反射防止フィルムを100℃で十分に乾燥させた。このようにして、酸化処理済み反射防止フィルム を作割した。

[0125] (11) 餘化処理による腰の剥がれの評価 餘化処理過程での腰の剥が計評価した。100枚の反射 防止フィルムを餘化処理した。餘化処理前と餘化処理後 における腰の剥がれの有無を目視で観察し、下記の3段 職評価を行った。

〇:100枚全てにおいて剥がれが全く認められなかったもの

×:剥がれが認められたものが5枚をこえたもの

(12) 碁盤目密着の評価

偏光振用保護フィルムを温度26℃、相対温度60%の 条件で2時間調湿した。偏光振用保護フィルムの最外層 を有する側の表面において、カッターナイフで碁盤目状 に織11末、横11末の切り込みを入れ、日東電エ

- (株) 製のポリエステル粘着テープ(NO. 31B)に おける密着試験を同じ場所で繰り返し3回行った。膜の 繋がれの有無を目視で観察し、下記の3段階評価を行っ た。
- O:100 升において剥がれが全く認められなかったも
- △:剥がれが認められたものが2升以内のもの
- ×:剥がれが認められたものが2升をこえたもの

【0126】 敏化処理を行った、剥がれ、密着評価結果 について記す。本発明のいずれの試料においても、截化 処理による膜の剥がれ、および基盤目密着の剥がれは、 級家されなかった。また、本発明の試料について、防蚊 性ハードコート層および低度折率層とは支持体を挟んだ 反対側面の水に対する接触角を測定したところ、いずれ の試料においても40°から30°の範囲に入ってい た。

【0127】 【実施例2】 防蚊性ハードコート層イ〜 ニ、 低屈折率層A〜1 を実施例1と同様にして塗布し た、 積層の組み合わせは表5に記載のとおりにおこなっ た。

[0128]

【表5】

紅料瓶	防蚊性ハードコート 用塗布液	低屈折率雇用整布		
201 (比較例)	1	A		
202 (本発明)	D	A		
203 (本発明)	^	A		
204 (本発明)	=	A		
205 (本発明)	ホ	A		
206 (本発明)	p	В		
207(本発明)	p	C		
208 (本発明)	р	D		
209 (本発明)	D	E		
210 (本発明)	D	7		
211 (本発明)	P	G		
212 (本発明)	P	H		
213 (本発明)	-	I		
214 (本発明)	Λ	D		
215 (本発明)	, n	E		
216 (本発明)	, , , , ,	F		
217 (本発明)	λ.	G		
218 (本発明)	, n	H		
219 (本発明)	=	D		
220 (本発明)	=	E		
221 (本発明)	=	F		
222 (木発明)	=	G		
223 (本発明)	=	H		
224 (本発明)	ホ	D		
225 (本発明)	赤	E		
226 (本発明)	亦	F		
227 (本発明)	本	G		
228(本発明)	亦	H		

【0129】 (反射防止膜の評価) 得られた試料201 名男の試料202~228日ごりで、いずれの試料においても、指数付着性は0で、防敗性は20で、ドラツキは Oであり、反射防止性能と約季度度も防眩性反射防止7 Oであり、反射防止性能と約季度度も防眩性反射防止7 ルルに応多とされる性能化ベルを越えていた。その他 の評価結果について表6に示す。本発明の試料202~ 228は、止影例試料201に比べて、実施例1と同様 に、ステールウール制傷性と結構をこり性能が優れてい ることが分かる。特に、防眩性ハードコート層と低屈折 率層の調度に本美明の化合物を含有した系が耐傷性能に 軽析ることが分かる。これらの製料は本発明のシラン系 化合物の含有によることが明らかである。

[0130] [表6]

ECPAN.	平均反射 率(%)	ヘイズ (%)	鉛筆硬度	接触角*	動學祭师数	びー1クー1前 傷性	鉱棒ごすり
201 (比較例)	2.1	42.9	Δ	102	0.08	×	×
202 (本発明)	2.1	41.7	0	101	0.08	0	ΟΔ
203 (本発明)	2.0	43.1	0	103	0.08	0	ΔΟ
204 (本発明)	2.0	43.2	0	102	0.08	0	- ΟΔ
205 (本発明)	1.9	42.6	0	102	0.08	0	ΔΟ
206 (本発明)	2.0	42.7	_ 0	103	0.08	0	ΔΟ
207 (本発明)	2.0	42.6	0	102	0.08	0	ΦΦ
208 (本発明)	2.1	41.4	0	101	0.08	0	8
209 (本発明)	2.1	43.1	0	102	0.06	0	9
210 (本発明)	1.9	42.3	0	102	0.08	9	Ð
211 (本発明)	2.0	42.6	0	103	0.06	9	0
212 (本発明)	1.9	43.9	0	101	0.07	0	9
213 (本発明)	2.0	42.6	0	109	0.08	0	0
214 (本発明)	2.0	43.7	0	100	0.08	0	0
215 (本発明)	2.1	43.0	0	102	0.08	0	0
216 (本発明)	2.0	42.9	_0	101	0.08	0	0
217 (本発明)	1.9	42.8	0	102	0.08	0	0
218 (本発明)	1.9	42.9	0	102	0.07	0	0
219 (本発明)	2.1	42.6	0	102	0.08	0	О
220 (本発明)	2.0	42.5	0	101	0.08	0	0
221 (本発明)	2.0	43.1	0	103	0.07	0	0
222 (本発明)	1.9	43.1	0	102	80.0	0	0
223 (本発明)	2.1	42.6	0	102	0.08	0	0
224 (本発明)	2.0	42.3	0	103	0.08	ΔΟ	ΔΟ
225 (本発明)	2.0	42.5	0	102	0.08	ΔΟ	ΔΟ
226 (本発明)	1.9	43.1	0	103	0.08	ΔΟ	ΟΔ
227 (本発明)	2.0	41.6	0	101	0.08	ΟΔ	ΔΟ
228 (本発明)	2.0	42.4	0	101	0.07	OΔ	OΔ

[0131] 次に、本発明の試料202~228のフィルムを用いて防弦性反射防止偏光板を作成した。この偏 光板を用いて反射防止傷を長表層に配置した液晶表示装 置を作成したところ、外光の映り込みがないために優れ たコントラストが得られ、防波性により反射像が目立た 本発明の試料を偏光子の片側に貼合し、反対側に透明支 持体およびディスコティック洗品の配向を固定した光学 現方層から構成される光学裕値フィルムを貼合した楕円 偏光板を用いて液晶表示装置を作製して視距性を評価したところ、外光の映り込みがなく、優れたコントラスト 有していた。

【0132】(反射防止フィルムの酸化処理) 前記試料 202~228について、美施例1と同様の酸化処理を 行った。酸化処理を行った試料201~228につい て、実施例1と同様の酸化処理による膜の剥がれ、基盤 目密着の評価を行った。その結果、いずれの試料におい ても、酸化処理による膜の剥がれ、および基盤目密着の 剥がれは、観察されなかった。また、本受明の試料20 2~228について、防眩性ハードコート層よび低屈 折率層とは支持体を挟んだ反対側面の水に対する接触角 を測定したところ、いずれの試料においても40°から 30°の範囲に入っていた。

【0133】 [実施例3] PVAフィルムをヨウ素2. Og/1、ヨウ化カリウム4. Og/1の水溶液に25 ℃にて240秒浸漬し、さらにホウ酸10g/1の水溶 液に25℃にて60秒浸漬後、図2の形態のテンター延 伸機に導入し、5. 3倍に延伸し、テンターを延伸方向 に対し図2の如く屈曲させ、以降幅を一定に保った。8 0℃雰囲気で乾燥させた後テンターから離脱した。左右 のテンタークリップの搬送速度差は、0.05%未満で あり、導入されるフィルムの中心線と次工程に送られる フィルムの中心線のなす角は、46°であった。ここで | L1-L2 | は0.7m、Wは0.7mであり、| L 1-L2 = Wの関係にあった。テンター出口における 実質延伸方向Ax-Cxは、次工程へ送られるフィルム の中心線22に対し45°傾斜していた。テンター出口 におけるシワ、フィルム変形は観察されなかった。さら に、PVA ((株) クラレ製PVA-117H) 3%水 溶液を接着剤としてケン化処理した富士写真フィルム

(株) 製フジタック (セルローストリアセテート、レタ ーデーション値3. Onm) と貼り合わせ、さらに80 ℃で乾燥して有効幅650mmの偏光板を得た。得られ た偏光板の吸収軸方向は、長手方向に対し45°傾斜し ていた。この偏光板の550nmにおける透過率は4 3. 7%、偏光度は99. 97%であった。さらに図8 の如く310×233mmサイズに裁断したところ、9 1. 5%の面積効率で辺に対し45 吸収軸が傾斜した 偏光板を得た。次に、実施例1の本発明の試料104、 106~110, 112, 114, 119~121, 1 24~142, 144, 146~149, 151, 15 2の鹸化処理したフィルムを上記偏光板と貼り合わせて 防眩性反射防止付き偏光板を作製した。この偏光板を用 いて反射防止層を最表層に配置した液晶表示装置を作製 したところ、外光の映り込みがないために優れたコント ラストが得られ、防眩性により反射像が目立たず優れた 視認性を有していた。

【0134】 [実施例4] 上記実施例3の45* 吸収軸 が傾斜した偏光板作製の中の、「富士写真フィルム (株) 製フジタック(セルローストリアセテート、レタ 奏明の試料104、106~110、112、114、 119~121、124~142、144、146~ 49、151、152の輸作処理したフィルルを獲り合 わせて防眩性反射防止付き傷光板を作製した。この偏光 板を用いて反射防止停を最表層に配置した液晶表示装置 を作製したところ、実施例の同様に、外光の映り込みが ないために優れたコントラストが得られ、防眩性により 反射像が目立たず優れた複数性を有していた。

【0135】 [実施例5] 実施例1で作製した本祭明の 試料104、106~110、112、114、119 ~121, 124~142, 144, 146~149, 151、152を、1.5規定、55℃のNaOH水溶 液中に2分間浸漬したあと中和、水洗してフィルムの裏 面のトリアセチルセルロース面を鹸化処理し、80μm の厚さのトリアセチルセルロースフィルム(TAC-T D80U、富士写真フイルム(株)製)を同条件で厳化 処理したフィルムにポリビニルアルコールにヨウ素を吸 着させ、延伸して作製した偏光子の両面を接着、保護し て偏光板を作製した。このようにして作製した偏光板 を、反射防止膜側が最表面となるように透過型TN液晶 表示装置搭載のノートパソコンの液晶表示装置(偏光選 択層を有する備光分離フィルムである住友3M(株)製 のD-BEFをバックライトと液晶セルとの間に有す る) の視認側の偏光板と貼り代えたところ、背景の映り こみが極めて少なく、表示品位の非常に高い表示装置が 得られた。

[0136] [実施例6] 実施例1で作製した本発明の 試料104、106~110、112、114、119 ・121、124~142、144、146・149、 151、152を貼りつけた透過型TN液晶セルの視認 側の個光板の液晶セル側の保護フィルム、およびバック ライト側の低光板の液晶・内の保護フィルムに、ディ スコティック構造単位の円盤面が透明支持体面に対して 傾いており、且つ該ディスコティック構造単位の円盤面 と透現支持体にのなす角度が、光学真方層の突き方向 において変化している光学補復層を有する視野角拡大フ ィルム(ワイドビューフィルムSA-126、富士写真フィルム(ド)線)を用いたところ、明室でコントラ ストに優れ、且つ、上下左右の視野角が非常に広く、極 めて視認性に優れ、表示品位の高い液晶表示装置が得ら れた。

【0137】 [実施例7] 実施例1で作製した本発明の 試料104、106~110、112、114、114 ~121、124~142、144、146~149、 151、152を、有機EL表示装置の表面のガラス板 に粘着剤を介して貼り合わせたところ、ガラス表面での 反射が明えられ、視認性の高い表示装置が得られえた。 [0138】 [実施例1で作製した本発明の 試料104、106~110、112、114、119 151、152を用いて、片面反射防止フィルム付き個 大板を作製し、偏光板の反射防止膜を有している側の反 対面に入く4板を張り合わせ、有機し長を装置の表面 のガラス板に貼り付けたところ、表面反射および、表面 ガラスの内部からの反射がカットされ、様めて視認性の 高い表示が得られた。

【図面の簡単な説明】

【図1】 防眩性反射防止フィルムの層構成を示す断面 模式図である。

【図2】 実施例3で使用のテンター延伸機を示す概略 図である。

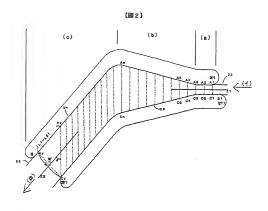
【符号の説明】

- 1 防眩性反射防止フィルム
- 2 透明支持体
- 3 ハードコート層
- 4 防眩性ハードコート層
- 5 低屈折率層
- 6 マット粒子
- (イ) フィルム導入方向
- (ロ) 次工程へのフィルム搬送方向
- (a) フィルムを導入する工程

- (b) フィルムを延伸する工程
- (c) 延伸フィルムを次工程へ送る工程
- A 1 フィルムの保持手段への噛み込み位置とフィルム 延伸の起点位置(実賃保持開始点:右)
- B1 フィルムの保持手段への噛み込み位置(左)
- C1 フィルム延伸の起点位置(実質保持開始点:左) Cx フィルム離脱位置とフィルム延伸の終点基準位置
- (実質保持解除点:左) Ay フィルム延伸の終点基準位置(零電保持解除点:
- 右) フィルムを作りた点を手也直(矢具体対所除点: 右)
- |L1-L2| 左右のフィルム保持手段の行程差
- W フィルムの延伸工程終端における実質幅 θ 延伸方向とフィルム進行方向のなす角
- 21 導入側フィルムの中央線
- 22 次工程に送られるフィルムの中央線
- 23 フィルム保持手段の軌跡(左)
- 24 フィルム保持手段の軌跡(右)
- 25 導入側フィルム
- 26 次工程に送られるフィルム
- 27、27 左右のフィルム保持開始(噛み込み)点
- 28、28' 左右のフィルム保持手段からの離脱点

[図1]





フロントページの続き

> JL06 JN01A JN06 JN10 JN18C YY00C